

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/001381

International filing date: 01 February 2005 (01.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-031435
Filing date: 06 February 2004 (06.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 24 February 2005 (24.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

02.2.2005

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 2 月 6 日

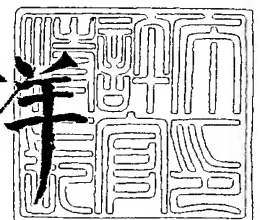
出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 3 1 4 3 5
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 3 1 4 3 5]

出 願 人
Applicant(s): 日 本 電 気 株 式 会 社

2 0 0 4 年 9 月 2 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川 洋



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 8 7 1 9 2

【書類名】 特許願
【整理番号】 34103849
【提出日】 平成16年 2月 6日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 B01J 19/00
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内
 【氏名】 飯田 一浩
【特許出願人】
 【識別番号】 000004237
 【氏名又は名称】 日本電気株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100110928
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 速水 進治
 【電話番号】 03-5784-4637
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 138392
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0110433

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

第一の液体の通る第一の流路と、
前記第一の流路に連通し、前記第一の液体を堰き止める堰き止め部と、
第二の液体を前記堰き止め部に導く第二の流路と、
を備え、
前記第一の流路から前記第二の流路への前記第一の液体の通過を制御することを特徴とする制御構造。

【請求項 2】

第一の流路と、
第二の流路と、
これらの流路に連通する連通部と、
前記連通部に設けられ、第一の流路から第二の流路への第一の液体の流動を堰き止める堰き止め部と、を備え、
前記堰き止め部は；
第二の流路に液体が存在しないとき、前記第一の流路から前記第二の流路への前記第一の液体の通過を制限し、
第二の流路に液体が存在するとき、前記第一の流路と前記第二の流路との間の液体の流通を許容する
ことを特徴とする制御構造。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の制御構造において、
前記第一の流路と、前記第二の流路とは、前記堰き止め部の近傍の領域で互いに並行することを特徴とする制御構造。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 いずれかに記載の制御構造において、
前記第一の流路および前記第二の流路は、単一の基板上に形成されている流路溝であることを特徴とする制御構造。

【請求項 5】

請求項 1 乃至 4 いずれかに記載の制御構造において、
前記堰き止め部は、前記第一の液体に対する疎液性が前記第一の流路よりも高い領域を備えることを特徴とする制御構造。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 いずれかに記載の制御構造において、
前記堰き止め部は、前記第一の流路の単位体積あたり表面積よりも大きい単位体積あたり表面積を有することを特徴とする制御構造。

【請求項 7】

請求項 1 乃至 6 いずれかに記載の制御構造において、
前記堰き止め部は、前記第一の流路と前記第二の流路とを隔てる隔壁に設けられた複数の連通流路からなることを特徴とする制御構造。

【請求項 8】

請求項 1 乃至 7 いずれかに記載の制御構造において、
前記堰き止め部は、多孔質体を備えることを特徴とする制御構造。

【請求項 9】

請求項 1 乃至 8 いずれかに記載の制御構造において、
前記堰き止め部は、単数または複数の突起部を備えることを特徴とする制御構造。

【請求項 10】

請求項 1 乃至 9 いずれかに記載の制御構造において、
前記第一の流路は、外部雰囲気と連通する第一の開口部を備え、
前記第二の流路は、外部雰囲気と連通する第二の開口部を備えることを特徴とする制御

構造。

【請求項 1 1】

請求項 1 乃至 1 0 いずれかに記載の制御構造を備える装置。

【請求項 1 2】

試料液中の特定物質を分離する分離部と、

請求項 1 乃至 1 0 いずれかに記載の制御構造と、

前記試料液の導入部と、

洗浄液の導入部と、

前記特定物質の脱離液の導入部と、

を備え、

前記制御構造は、前記分離部と前記第一の流路を介して連通し、

前記試料液の導入部および前記洗浄液の導入部は、前記第一の流路に、前記制御構造と前記分離部との間で連通し、

前記脱離液の導入部は、前記制御構造に前記第二の流路を介して連通することを特徴とする分離装置。

【請求項 1 3】

請求項 1 2 に記載の分離装置の洗浄方法であって、

前記洗浄液の導入部に洗浄液を導入し、前記第一の流路に前記洗浄液を流入させ、前記分離部を前記洗浄液で洗浄するステップを備えることを特徴とする洗浄方法。

【請求項 1 4】

請求項 1 2 に記載の分離装置による特定物質の分離方法であって、

前記試料液の導入部に前記試料液を導入し、前記第一の流路に前記試料液を流入させ、前記分離部に前記特定物質を取り込ませるステップと、

前記洗浄液の導入部に洗浄液を導入し、前記第一の流路に前記洗浄液を流入させ、前記分離部を前記洗浄液で洗浄するステップと、

前記脱離液の導入部に脱離液を導入し、前記第二の流路および前記制御構造を介して前記脱離液を前記第一の流路に流入させ、前記特定物質を前記分離部から脱離させるステップと、

を備えることを特徴とする分離方法。

【請求項 1 5】

第一の組成液が流れる順流路と、

前記順流路と並行し、第二の組成液が流れる逆流路と、

前記順流路に連通し、前記第一の組成液の原液を前記順流路に導入する第一の導入部と

、
前記順流路の下流側において前記逆流路に連通し、前記第二の組成液の原液を前記逆流路に導入する第二の導入部と、

前記順流路と前記逆流路とを隔て、前記第一の組成液または前記第二の組成液の少なくとも特定成分が通過可能な隔壁と、

前記順流路の下流側において前記順流路に連通し、前記特定成分が濃度勾配を示す前記第一の組成液を採取するグラディエント液採取部と、

を備えることを特徴とするグラディエント形成装置。

【請求項 1 6】

請求項 1 5 に記載のグラディエント形成装置において、

前記順流路および前記逆流路は、単一の基板上に形成されている流路溝であることを特徴とするグラディエント形成装置。

【請求項 1 7】

請求項 1 5 または 1 6 に記載のグラディエント形成装置において、

前記隔壁は、前記順流路および前記逆流路に連通する複数の流路を備えることを特徴とするグラディエント形成装置。

【請求項 1 8】

請求項 1 5 または 1 6 に記載のグラディエント形成装置において、
前記隔壁は、少なくとも前記特定成分を透過させる膜からなることを特徴とするグラディエント形成装置。

【請求項 1 9】

請求項 1 5 乃至 1 8 いずれかに記載のグラディエント形成装置において、
前記逆流路の前記隔壁と接する領域の下流側に設けられた、前記第二の組成液を堰き止める堰き止め部と、前記堰き止め部またはその下流側の箇所前記逆流路に連通し、前記第一の導入部またはその下流側の箇所前記順流路と連通し、前記堰き止め部へ前記第一の組成液を導くトリガー流路と、を備える液体スイッチをさらに備えることを特徴とするグラディエント形成装置。

【請求項 2 0】

請求項 1 8 または 1 9 に記載のグラディエント形成装置により、特定成分が経時的または距離的な濃度勾配を示す液流を形成するグラディエント形成方法であって、
前記第二の導入部に、前記第二の組成液の原液を導入するステップと、
前記第一の導入部に、前記第一の組成液の原液を導入するステップと、
前記グラディエント液採取部より、前記特定成分が濃度勾配を示す前記第一の組成液を採取するステップと、
を備えることを特徴とするグラディエント形成方法。

【請求項 2 1】

基板と、前記基板上に形成されている請求項 1 2 に記載の分離装置と、前記基板上に形成されているグラディエント形成装置と、を備え、
前記グラディエント形成装置は；
第一の組成液が流れる順流路と、
前記順流路と並行し、第二の組成液が流れる逆流路と、
前記順流路に連通し、前記第一の組成液の原液を前記順流路に導入する第一の導入部と

前記順流路の下流側において前記逆流路に連通し、前記第二の組成液の原液を前記逆流路に導入する第二の導入部と、

前記順流路と前記逆流路とを隔て、前記第一の組成液または前記第二の組成液の少なくとも特定成分が通過可能な隔壁と、

前記順流路の下流側において前記順流路に連通し、前記特定成分が濃度勾配を示す前記第一の組成液を採取するグラディエント液採取部と、
を備え、

前記グラディエント液採取部は；

前記分離装置に含まれる前記脱離液の導入部と連通することを特徴とするマイクロチップ。

【請求項 2 2】

請求項 2 1 に記載のマイクロチップによる前記特定物質の分離方法であって、
前記試料液の導入部に前記試料液を導入し、前記第一の流路に前記試料液を流入させ、前記分離部に前記特定物質を取り込ませるステップと、
前記洗浄液の導入部に洗浄液を導入し、前記第一の流路に前記洗浄液を流入させ、前記分離部を前記洗浄液で洗浄するステップと、
前記第二の導入部に、前記第二の組成液の原液を導入するステップと、
前記第一の導入部に、前記第一の組成液の原液を導入するステップと、
前記グラディエント液採取部より、前記特定成分が濃度勾配を示す前記第一の組成液からなる脱離液を得るステップと、

前記脱離液の導入部に前記脱離液を導入し、前記第二の流路および前記制御構造を介して前記脱離液を前記第一の流路に流入させ、前記特定物質を前記分離部から脱離させるステップと、
を備えることを特徴とする分離方法。

【請求項 2 3】

生体試料を分子サイズまたは性状に応じて分離する分離手段と、前記分離手段により分離された試料に対し、酵素消化処理を含む前処理を行う前処理手段と、前処理された試料を乾燥させる乾燥手段と、乾燥後の試料を質量分析する質量分析手段と、を備え、

前記分離手段は、請求項 2 1 に記載のマイクロチップを含むことを特徴とする質量分析システム。

【書類名】明細書

【発明の名称】制御構造、グラディエント形成装置およびそれらを用いるマイクロチップなど

【技術分野】

【0001】

本発明は、制御構造、グラディエント形成装置およびそれらを用いるマイクロチップなどに関する。

【背景技術】

【0002】

近年、試料の前処理・反応・分離・検出などの化学操作をマイクロチップ上で行うマイクロ化学分析 (μ -TAS) が急速に発展しつつある。マイクロ化学分析によれば、使用する試料が微量で済み、環境負荷も小さく高感度な分析が可能となる。

【0003】

特許文献1には、基板上に溝やリザーバを設けた構成のマイクロチャンネル型チップにより、キャピラリ電気泳動を実現する装置が記載されている。この種のマイクロチップにおいては、チップ内の流路や反応部位に試料やバッファを導入する際、またはその後に、流路や反応部位を洗浄するための洗浄液を導入する際などに、混合が不要な溶液同士の混合を抑制することが重要となる。こうした技術は、分離装置や分析装置のみならず、マイクロ化学反応装置などにおいても同様に求められる。

【0004】

一方、アフィニティークロマトグラフィーは、不溶性の担体に分離、精製を目的とする物質に対する特異的相互作用を有する物質を固定化して親和性吸着体を作製し、これをカラムに充填して試料溶液中の目的物質を親和性吸着体に吸着させて分離するクロマトグラフィーである。アフィニティークロマトグラフィーは、物質間の特異的相互作用を利用して成分を分離するため、特に生体由来物質の分離、精製に有用な方法である。

【0005】

しかし、カラムに充填して行うアフィニティークロマトグラフィーは、微量試料の分離効率が必ずしも充分ではなかった。

【0006】

そこで、こうしたマイクロチップを活用する技術において、アフィニティークロマトグラフィーの技術を導入する試みが提案されている (特許文献2)。この装置においては、流路中にビーズ等を担体とする親和性吸着体の充填領域が設けられており、流路に目的成分を含む試料を流すと、目的成分が親和性吸着体に吸着されるようになっている。

【0007】

このような構成では、目的の物質を親和性吸着体に吸着させた後、親和性吸着体から脱着させて回収する必要があるが、この際に高濃度の塩溶液や有機溶媒の濃度が経時的に変化するいわゆるグラディエント液を用いる場合がある。

【0008】

また、生体分子等を分離精製するクロマトグラフィーの中には、アフィニティークロマトグラフィーの他にも、展開溶液中の塩濃度や、有機溶媒濃度に経時的な濃度勾配 (グラディエント) をつけて流すことによって、通常のゲルろ過クロマトグラフィーなどでは分離困難な物質を分離する手段がある。例えばイオン交換クロマトグラフィー、疎水性クロマトグラフィー、逆相クロマトグラフィー等である。

【特許文献1】特開2002-207031号公報

【特許文献2】特開2002-502597号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

マイクロチップにおいて、不要な溶液同士の混合を防ごうとすると、特に流路の洗浄操作の後に、流路に残存する洗浄液が、別の反応液の導入部へと逆流する場合がある。そ

のため、混合が不要な溶液同士の混合を抑制するという課題がある。

【0010】

なお、逆流を抑制するために別の反応液の導入側にあらかじめ水压をかけておく方法も想定される。しかし、マイクロチップのような微細な構造の装置においては、溶液にかかる圧力の調節が困難である。また、圧力調節装置をマイクロチップに外付けすると、マイクロチップが大型化する。そのため、マイクロチップの小型化は困難であった。

【0011】

また、従来は、上記の各種クロマトグラフィーは、一般にカラムを用いて実施されているため、グラディエント液を形成するためには、サンプルや溶媒が比較的多量に必要であった。そのため、マイクロチップによりグラディエント液を用いるクロマトグラフィーを実施しようとする、グラディエント液を作るための外付け装置が必要であった。

【0012】

図10は、通常のサイズのカラムによるクロマトグラフィーのためにグラディエント形成を行う従来のグラディエント形成装置を示す概略図である。

【0013】

マイクロチップにおけるカラムクロマトグラフィーのために、グラディエント液を形成する必要がある場合、従来技術を用いると、以下のような構成からなる外付け装置が必要であった。

【0014】

例えば、図10(A)に示すように、第一の容器304AにA溶液302Aを用意し、第二の容器304BにB溶液302Bを用意する必要がある。そして、A溶液の流路306Aに設けられたA溶液の可変ポンプ308AによりA溶液を供給し、B溶液の流路306Bに設けられたB溶液の可変ポンプ308BによりB溶液を供給し、混合溶液を形成する。そして、その混合溶液を流路312によりマイクロチップに供給する。

【0015】

そして、図10(B)に示すように、A液側とB液側のポンプの流量を調節することで、特定物質の濃度の経時的なグラディエントを有する混合溶液をマイクロチップに供給する必要があった。

【0016】

本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、微細なスケールで液体の通過を制御する制御構造を実現する技術を提供することを目的とする。また、本発明の別の目的は、微細なスケールでグラディエント液を作成するグラディエント形成装置を実現する技術を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0017】

本発明によれば、第一の液体の通る第一の流路と、第一の流路に連通し、第一の液体を堰き止める堰き止め部と、第二の液体を堰き止め部に導く第二の流路と、を備え、第一の流路から第二の流路への第一の液体の通過を制御する制御構造が提供される。

【0018】

このような構成によれば、第一の液体を堰き止める堰き止め部を備えるため、第二の流路内に液体が存在しない場合には、第一の流路から第二の流路への第一の液体の通過が堰き止め部により堰き止められる。その結果、この第二の流路内に液体を導入するか否かにより制御構造の開閉を制御することができ、微細なスケールで液体の通過を制御する制御構造を実現することができる。

【0019】

また、本発明によれば、第一の流路と、第二の流路と、これらの流路に連通する連通部と、連通部に設けられ、第一の流路から第二の流路への第一の液体の流動を堰き止める堰き止め部と、を備え、堰き止め部は、第二の流路に液体が存在しないとき、第一の流路から第二の流路への第一の液体の通過を制限し、第二の流路に液体が存在するとき、第一の流路と第二の流路との間の液体の流通を許容する制御構造が提供される。

【0020】

このような構成によれば、第二の流路に液体が存在しないとき、第一の流路から第二の流路への第一の液体の通過を制限し、第二の流路に液体が存在するとき、第一の流路と第二の流路との間の液体の流通を許容するので、第二の流路内に液体を導入するか否かにより制御構造の開閉を制御することができ、微細なスケールで液体の通過を制御する制御構造を実現することができる。

【0021】

また、本発明によれば、第一の組成液が流れる順流路と、順流路と並行し、第二の組成液が流れる逆流路と、順流路に連通し、第一の組成液の原液を順流路に導入する第一の導入部と、順流路の下流側において逆流路に連通し、第二の組成液の原液を逆流路に導入する第二の導入部と、順流路と逆流路とを隔て、第一の組成液または第二の組成液の少なくとも特定成分が通過可能な隔壁と、順流路の下流側において順流路に連通し、特定成分が濃度勾配を示す第一の組成液を採取するグラディエント液採取部と、を備えるグラディエント形成装置が提供される。

【0022】

このような構成によれば、順流路と逆流路とを隔て、第一の組成液または第二の組成液の少なくとも特定成分が通過可能な隔壁が設けられているため、第一の組成液と第二の組成液とが対向流を形成しながら混合することとなる。その結果、微細なスケールでグラディエント液を作成するグラディエント形成装置を実現することができる。

【0023】

本明細書において、グラディエント形成装置とは、2種類以上の組成の液体を混合することにより、濃度勾配（グラディエント）を有する液体を形成する装置を意味する。2種類以上の液体としては、特に限定する趣旨ではないが、塩溶液とバッファー溶液との組合せなどがあり得る。

【0024】

以上、本発明の構成について説明したが、これらの構成を任意に組み合わせたものも本発明の態様として有効である。

【0025】

また、本発明の制御構造を、その制御構造を用いる装置または分離装置、その分離装置の洗浄方法またはその分離装置を用いる特定物質の分離方法などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

【0026】

さらに、本発明のグラディエント形成装置を、そのグラディエント形成装置を用いるグラディエント形成方法などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

【0027】

そして、本発明の制御構造およびグラディエント形成装置を、それらを組み合わせた装置またはマイクロチップ、そのマイクロチップを用いる特定物質の分離方法または質量分析システムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

【発明の効果】**【0028】**

本発明によれば、微細なスケールで液体の通過を制御する制御構造を実現することができる。または、本発明によれば、微細なスケールでグラディエント液を作成するグラディエント形成装置を実現することができる。

【発明を実施するための最良の形態】**【0029】**

本発明による制御構造において、第一の流路と、第二の流路とは、堰き止め部の近傍の領域で互いに並行してもよい。また、第一の流路および第二の流路は、単一の基板上に形成されている流路溝であってもよい。

【0030】

堰き止め部は、第一の液体に対する疎液性が第一の流路よりも高い領域を備えてもよい

。堰き止め部は、第一の流路の単位体積あたり表面積よりも大きい単位体積あたり表面積を有してもよい。堰き止め部は、第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁に設けられた複数の連通流路からなってもよい。堰き止め部は、多孔質体を備えてもよい。堰き止め部は、単数または複数の突起部を備えてもよい。

【0031】

第一の流路は、外部雰囲気と連通する第一の開口部を備え、第二の流路は、外部雰囲気と連通する第二の開口部を備えてもよい。

本発明による装置は、上記の制御構造を備える装置である。

【0032】

本発明による分離装置は、試料液中の特定物質を分離する分離部と、上記の制御構造と、試料液の導入部と、洗浄液の導入部と、特定物質の脱離液の導入部と、を備える分離装置である。この制御構造は、分離部と前記第一の流路を介して連通する。この試料液の導入部および洗浄液の導入部は、第一の流路に、制御構造と分離部との間で連通する。この脱離液の導入部は、制御構造に第二の流路を介して連通する。

【0033】

また、本発明による分離装置の洗浄方法は、洗浄液の導入部に洗浄液を導入し、第一の流路に洗浄液を流入させ、分離部を前記洗浄液で洗浄するステップを備える洗浄方法である。

【0034】

本発明による分離装置による特定物質の分離方法は、試料液の導入部に試料液を導入し、第一の流路に試料液を流入させ、分離部に特定物質を取り込ませるステップと、洗浄液の導入部に洗浄液を導入し、第一の流路に洗浄液を流入させ、分離部を洗浄液で洗浄するステップと、脱離液の導入部に脱離液を導入し、第二の流路および制御構造を介して脱離液を第一の流路に流入させ、特定物質を分離部から脱離させるステップと、を備える分離方法である。

【0035】

順流路および逆流路は、単一の基板上に形成されている流路溝である構成としてもよい。隔壁は、順流路および逆流路に連通する複数の流路を備える構成としてもよい。隔壁は、少なくとも特定成分を透過させる膜からなる構成としてもよい。

【0036】

本発明によるグラディエント形成装置は、逆流路の隔壁と接する領域の下流側に設けられた、第二の組成液を堰き止める堰き止め部と、堰き止め部またはその下流側の箇所では逆流路に連通し、第一の導入部またはその下流側の箇所では順流路と連通し、堰き止め部へ第一の組成液を導くトリガー流路と、を備える液体スイッチをさらに備えてもよい。

【0037】

本発明によるグラディエント形成方法は、上記のグラディエント形成装置により、特定成分が濃度勾配を示す液流を形成するグラディエント形成方法である。

【0038】

本発明によるグラディエント形成方法は、第二の導入部に、第二の組成液の原液を導入するステップと、第一の導入部に、第一の組成液の原液を導入するステップと、グラディエント液採取部より、特定成分が濃度勾配を示す第一の組成液を採取するステップと、を備えるグラディエント形成方法である。

【0039】

本発明によるマイクロチップは、基板と、基板上に形成されている上記の分離装置と、基板上に形成されているグラディエント形成装置と、を備えるマイクロチップである。グラディエント形成装置は、第一の組成液が流れる順流路と、順流路と並行し、第二の組成液が流れる逆流路と、順流路に連通し、第一の組成液の原液を順流路に導入する第一の導入部と、順流路の下流側において逆流路に連通し、第二の組成液の原液を逆流路に導入する第二の導入部と、順流路と逆流路とを隔て、第一の組成液または第二の組成液の少なくとも特定成分が通過可能な隔壁と、順流路の下流側において順流路に連通し、特定成分が

濃度勾配を示す第一の組成液を採取するグラディエント液採取部と、を備える。グラディエント液採取部は、分離装置に含まれる脱離液の導入部と連通する。

【0040】

本発明による特定物質の分離方法は、上記のマイクロチップを用いる。本発明による特定物質の分離方法は、試料液の導入部に試料液を導入し、第一の流路に試料液を流入させ、分離部に特定物質を取り込ませるステップと、洗浄液の導入部に洗浄液を導入し、第一の流路に洗浄液を流入させ、分離部を洗浄液で洗浄するステップと、第二の導入部に、第二の組成液の原液を導入するステップと、第一の導入部に、第一の組成液の原液を導入するステップと、グラディエント液採取部より、特定成分が濃度勾配を示す第一の組成液からなる脱離液を得るステップと、脱離液の導入部に脱離液を導入し、第二の流路および制御構造を介して脱離液を第一の流路に流入させ、特定物質を分離部から脱離させるステップと、を備える分離方法である。

【0041】

本発明による質量分析システムは、生体試料を分子サイズまたは性状に応じて分離する分離手段と、分離手段により分離された試料に対し、酵素消化処理を含む前処理を行う前処理手段と、前処理された試料を乾燥させる乾燥手段と、乾燥後の試料を質量分析する質量分析手段と、を備える質量分析システムである。この分離手段は、上記のマイクロチップを含む。

【0042】

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。

【0043】

本明細書において、特に断りがない限り、導入される液体は水溶液に限定されず、有機溶媒や、有機溶媒と水溶液との混合溶液、あるいは微小な粒子が分散した液体なども含むものとする。

【0044】

また、上述した制御構造またはグラディエント形成装置は、流路が基板に設けられた溝によって実現される構成とすることができる。基板表面に作り込まれた溝を流路とすることにより、上述した制御構造またはグラディエント形成装置は、以下の作用効果を奏する。

【0045】

第一に、流路のサイズ（幅、深さ）を所望の値に制御性良く作製することができる。このため、精度の高い液体の通過の制御または好適なグラディエントの形成が実現できる。

【0046】

第二に、流路間に設けられた隔壁の開口部の断面形状などを所望の形状に制御性良く加工することができる。たとえば、非常に微細な細孔を多数備える隔壁を形成することができる。また、逆洗浄のしやすい形状の開口部を備える隔壁とすることができる。

【0047】

第三に、製造安定性、量産性に優れる制御構造またはグラディエント形成装置とすることができる。上記構成は、基板としてガラスやシリコン等を用いる場合、ドライエッチングまたはウェットエッチングを利用して作製することができる。

【0048】

また、熱可塑性樹脂により基板を構成する場合、射出成型により作製することができる。さらに熱硬化性樹脂により基板を構成する場合、所定の凹凸表面を有する金型を当接させた状態で加圧することによって形成することができる。

【0049】

また、上述した制御構造を備える分離装置およびグラディエント形成装置は、同一の基板上に設けられた構成とすることができる。このような構成とすることにより、いったんアフィニティーカラムなどで吸着などされた試料に対してグラディエント溶液による脱離などを行うことができ、複数のステップからなる処理を連続的に実行することができる。

このため、従来複数の装置を要していた分離処理を一つの装置で実行することが可能となり、分離処理の効率を顕著に向上させることができる。

【0050】

なお、以下の各実施形態では基板として石英基板を用いるが、他の基板材料として、プラスチック材料、シリコン等を用いてもよい。プラスチック材料として、例えばシリコン樹脂、PMMA(ポリメタクリル酸メチル)、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PC(ポリカーボネート)等の熱可塑性樹脂や、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂が挙げられる。このような材料は成形加工が容易であり、製造コストを抑えることができる。

【0051】

また、以下の各実施形態では基板として石英基板を用いる場合は、マイクロチップの流路やリザーバ等の部分を形成する方法としては、フォトリソグラフィおよびエッチングを組み合わせた方法が挙げられるが、基板材料としてプラスチック材料を用いた場合は、射出成形、ホットエンボシング等の方法を採用することができる。

【0052】

また、以下の実施形態では毛細管力により流路内を液体が進行する装置を例に挙げて説明するが、ポンプや電界、引力等の外力を利用して液体を進行させる構成とすることもできる。

【0053】

さらに、本明細書において、「選択的に吸着または結合する」とは、被検物質のみが検出物質と吸着または結合し、試料中に含まれる他の物質は吸着または結合しないことをいう。吸着または結合の様式に制限はなく、物理的な相互作用であっても、化学的な相互作用であってもよい。また、選択的な吸着または結合のことを、以下適宜「特異的相互作用」と呼ぶ。

(実施形態1)

図1は、本実施形態の制御構造の構成を示す平面図である。

【0054】

本実施形態の制御構造は、第一の液体の通る第一の流路101と、第一の流路101に連通し、第一の液体を堰き止める堰き止め部104と、第二の液体を堰き止め部104に導く第二の流路102と、を備え、第一の流路101から第二の流路102への第一の液体の通過を制御する制御構造である。

【0055】

ここで、第一の流路101と、第二の流路102とは、図1に示すように、堰き止め部104の近傍の領域で互いに並行する構成としてもよい。すなわち、第一の流路101と、第二の流路102とは、各々の流路の側部で堰き止め部104と連通する構成としてもよい。

【0056】

このような構成とすることにより、第二の流路102内に第二の液体が存在しない場合には、堰き止め部104で第一の液体を堰き止めやすくなる。また、第二の流路102内に第二の液体が存在する場合には、堰き止め部104の断面積を比較的大きくすることができる。その結果、第一の液体が比較的スムーズに堰き止め部104を通過して第二の流路102内に進入しやすく、制御構造を通過する第一の液体の流量を比較的大きくできる。

【0057】

また、第一の流路101と、第二の流路102とは、図1に示すように、互いに略反対の方向から伸びてきて堰き止め部104の近傍で並行となってもよい。この場合、第二の流路102内に第二の液体が存在する場合には、第一の液体の進行方向が、第一の流路101内と第二の流路102内とで略同一方向となる。その結果、第一の液体が比較的スムーズに堰き止め部104を通過して第二の流路102内に進入しやすく、制御構造を通過する第一の液体の流量を比較的大きくできる。

【0058】

もつとも、第一の流路101と、第二の流路102とは、互いに略同一の方向から伸びてきて堰き止め部104の近傍で並行となってもよい。あるいは、互いに略直交する方向から伸びてきて堰き止め部104を介して交差してもよい。交差の形は、図1(D)に示すように、三方交差であってもよいし、あるいは四方交差であってもよい。また、互いに略反対の方向から伸びてきて堰き止め部104を介して突き合うこととなってもよい。

【0059】

すなわち、第一の流路101と、第二の流路102とは、堰き止め部104を介して連通すればよく、その伸張方向は特に限定されるものではない。どのような伸張方向または接触形状の組合せであっても、本実施形態の構成の制御構造を採用すれば、堰き止め部104で第一の液体の通過を制御することができる。

【0060】

図1(A)は、第一の流路101と、第二の流路102とが、互いに略反対の方向から伸びてきて堰き止め部104の近傍で並行となる構成において、第一の流路101の左から第一の液体を導入した場合の模式図である。このとき、進行方向の第二の流路102には、液体は導入されていない。

【0061】

このような制御構造を設けることにより、第一の液体の流れを一方通行にすることができる。この一方通行の向きは、進行方向側の第二の流路102内に溶液が存在するかどうかできる。すなわち、空気穴を有する第一の開口部106aがあるので、毛細管効果で第一の液体は第一の流路101の先端まで進むが、第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁1104に設けられた複数の連通流路からなる堰き止め部104の効果で第二の流路102に進入することなく停止してしまう。すなわち、図1(A)は、本実施形態の制御構造のいわゆる閉状態を示す。

【0062】

ここで、第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁1104に設けられた複数の連通流路からなる堰き止め部104は、構成上単位体積あたり表面積が第一の流路101よりも大きくなっている。また、第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁1104に設けられた複数の連通流路からなる堰き止め部104は第一の液体に対する疎液性の表面を備えていてもよい。いずれの場合も、第一の液体を第一の流路101方向に押し戻す方向に働く毛細管力が大きくなる。

【0063】

図1(B)では、あらかじめ進行方向である第二の流路102内に第二の液体が導入されている。このとき第一の流路101の左側から第一の液体を導入すると、毛細管効果で第一の流路101の先端まで進んだ第一の液体は、堰き止め部104を介してその反対側に液体が存在する。そのため、第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁1104に設けられた複数の連通流路からなる堰き止め部104を越えて第二の流路102へと進入する。なお、第一の液体に加わる通過圧力は、第二の液体に加わる通過圧力よりも大きいものとする。すなわち、図1(B)は、本実施形態の制御構造のいわゆる開状態を示す。

【0064】

この一方通行効果を利用することで、第一の液体の逆流を抑制し、混合が不要な溶液同士を抑制することができる。そのため、後述するように、この制御構造104を用いることで、アフィニティーカラムの洗浄などの際に洗浄液が逆流しないようにすることができる。

【0065】

ここで、本実施形態の制御構造104においては、第一の流路101および第二の流路102が、基板上に形成されている流路溝とすることもできる。例えば、本実施形態の制御構造104は、石英基板表面に溝部からなる流路および適当な構成を備える堰き止め部104を形成することにより作製することができる。なお、一般に石英基板の表面は親水性であるので、この溝部内壁は親水性表面となっている。

【0066】

このような構成を備えることにより、本実施形態の制御構造 104 をオンチップで他の装置などと一緒に作り込むことができる。そのため、本実施形態の制御構造およびそれを用いる装置を小型化することができる。また、半導体装置の技術分野などで利用されている微細加工技術を応用することにより、微細な構造からなる制御構造を精度よく作製することができる。

【0067】

また、この第一の流路 101 は、図 1 (A) に示すように、外部雰囲気と連通する第一の開口部 106a を備え、この第二の流路 102 は、外部雰囲気と連通する第二の開口部 106b を備えることができる。また、これらの開口部はそれぞれふたを備えてもよく、これらのふたは疎水性であってもよい。このような構成を備えることにより、ポンプや電界等の外力印加手段を有さなくても、毛細管力により流路内を第一の液体および第二の液体が進行していく。

【0068】

このとき、この第二の流路 102 は、毛細管力などの第二の液体に加わる通過圧力などにより、第二の液体を堰き止め部 104 に導入する構成を備えることができる。このような構成とすることにより、第二の流路 102 内に第二の液体が存在する場合には、毛細管力などにより第二の液体が堰き止め部 104 に導入されて第一の液体と互いに接触して、制御構造を開通させる。

【0069】

この際、通過圧力とは、第一の液体または第二の液体を、堰き止め部 104 を通過して反対側の流路内に進入させる方向にかかる圧力を意味する。例えば、毛細管力などが挙げられるが、これに限定されず、流路の後部の液体槽に溜まる液体からの圧力や、流路が傾いていることにより加わる重力による圧力や、機械的あるいは電氣的装置により流路内の液体に加わる圧力などであってもよい。

【0070】

このとき、第一の液体と第二の液体とは、同じ液体であってもよく、異なる液体であってもよい。たとえば、互いに水溶液であってもよく、互いに有機溶媒であってもよく、一方は水溶液で他方は有機溶媒であってもよい。

【0071】

また、第一の液体と第二の液体とが互いに接触する場合、第一の液体に加わる通過圧力の方が大きければ、第一の液体が堰き止め部 104 を通過して第二の流路 102 内に進入する。反対に、第二の液体に加わる通過圧力の方が大きければ、第二の液体が堰き止め部 104 を通過して第一の流路 101 内に進入する。

【0072】

また、上記の第一の流路 101 または第二の流路 102 は、流路内の親水性の程度や流路径等を適宜に調整することによって、制御構造 104 への進行方向の毛細管力を調整することができるため、流路内の液体の進行速度を調整することができる。これにより、制御構造 104 の開閉速度を調整することができる。

【0073】

なお、これらの流路の上面を被覆部材により被覆してもよい。流路の上面に被覆部材を設けることにより、試料液体の乾燥が抑制される。また、試料中の成分がタンパク質等高次構造を有する物質である場合、表面が親水性の被覆部材を用いて流路内を密閉することにより、気液界面においてこの成分が不可逆的に変性することが抑制される。

【0074】

ここで、この堰き止め部 104 は、第一の液体を堰き止めることのできる構成であれば、特に限定されず、任意の構成をとることができるが、例えば、この堰き止め部 104 は、第一の液体に対する疎液性が第一の流路 101 よりも高い領域を備える構成とすることができる。

【0075】

このような構成により、堰き止め部 104 において第一の液体を第二の流路 102 内に

進入を抑制する方向の毛細管力を、第一の液体を堰き止め部 104 を超えて第二の流路 102 内に進入させようとする通過圧力より大きくすることができ、堰き止め部 104 により第一の液体を堰き止めることができる。

【0076】

あるいは、この堰き止め部 104 は、第一の流路 101 の単位体積あたり表面積よりも大きい単位体積あたり表面積を有する構成とすることもできる。

【0077】

このような構成によっても、堰き止め部 104 において第一の液体を第二の流路 102 内に進入を抑制する方向の毛細管力を、第一の液体を堰き止め部 104 を超えて第二の流路 102 内に進入させようとする通過圧力より大きくすることができ、堰き止め部 104 により第一の液体を堰き止めることができる。

【0078】

一方、いずれの構成においても、第二の流路 102 内に液体が存在する場合には、第二の液体と第一の液体とが互いに接触することにより、堰き止め部 104 における第一の液体を第二の流路 102 内に進入を抑制する方向の毛細管力がいずれも消失または著しく減殺することとなるか、あるいは第二の液体に加わる毛細管力により相殺されるので、第一の液体は第一の液体に加わる通過圧力により第二の流路 102 内に進入する。

【0079】

よって、このような構成により、この第二の流路 102 内に第二の液体を導入するか否かにより制御構造の開閉を制御することができ、微細なスケールで液体の通過を制御する制御構造を実現することができる。

【0080】

この堰き止め部 104 は、具体的には、図 1 (C) に示すように、第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁 1104 に設けられた複数の連通流路からなる堰き止め部 104 とすることができる。なお、図 1 (C) は、図 1 (B) における堰き止め部 104 周辺の領域 100 の拡大図である。

【0081】

ここで、第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁 1104 に設けられた複数の連通流路からなる堰き止め部 104 は、構成上単位体積あたり表面積が第一の流路 101 よりも大きくなっている。また、第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁 1104 に設けられた複数の連通流路からなる堰き止め部 104 は第一の液体に対する疎液性の表面を備えていてもよい。いずれの場合も、第一の液体を第一の流路 101 方向に押し戻す方向に働く毛細管力が大きくなる。なお、このような第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁 1104 に設けられた複数の連通流路からなる堰き止め部 104 は、いわゆる平面限外濾過フィルタとしても機能し得る構成である。

(実施形態 2)

図 7 は、本実施形態の制御構造の構成を示す部分断面図である。

【0082】

本実施形態は、図 1 に示す構成からなる制御構造と基本的には同じ構成であるが、堰き止め部 104 が、第一の液体に対する疎液性が第一の流路よりも高い疎液性ふたを備える点で構成が異なる。なお、堰き止め部 104 以外の、第一の流路 101 および第二の流路 102 は、ともに親液性ふたを備えている。

【0083】

このような構成により、第一の液体を第一の流路 101 方向に押し戻す方向に働く毛細管力が大きくなる。そのため、第二の流路 102 に液体が存在しない場合には、第一の液体は表面張力により押し戻され、堰き止め部 104 の途中で停止する。その結果、堰き止め部 104 にて第一の液体を堰き止めることができる。

【0084】

なお、この場合、第一の液体が水溶液である場合には、上記の疎液性ふたは、その水溶液に対する疎水性が第一の流路よりも高い疎水性ふたとすることができる。

【0085】

このような構成を作製するには、まず、石英基板表面の第一の流路101、第二の流路102、および堰き止め部104に相当する箇所に溝部を形成することにより作製することができる。石英基板を用いるため溝部内部は親水性表面となっている。疎水領域を含む堰き止め部104は、石英ガラス表面を有する蓋部を疎水処理することなどにより得られる。

【0086】

この場合の疎水処理は、分子中に、基板材料と吸着ないし化学結合するユニットと、疎水性修飾基を有するユニットとを併せ持つ構造の化合物を、基板表面に付着ないし結合させること等により実現される。こうした化合物として、例えばシランカップリング剤等を用いることができる。疎水基を有するシランカップリング剤として好ましいものは、ヘキサメチルジシラザン等のシラザン結合基を有するものや、3-チオールプロピルトリエトキシシラン等のチオール基を有するものが挙げられる。

【0087】

堰き止め部の疎水性を適度に制御するためには、疎水処理をする材料の選択、量の適正化などがあるが、この他、流路の構造を好適に設計することによっても可能である。あるいは複数の疎水領域を略等間隔で規則的に配置することにより、疎水／親水パターンを形成することによって疎水性を制御することもできる。

【0088】

カップリング剤液等の塗布方法としては、スピncコート法、スプレー法、ディップ法、気相等が用いられる。スピncコート法とは、カップリング剤等、結合層の構成材料を溶解または分散させた液をスピncコーターにより塗布する方法である。この方法によれば膜厚制御性が良好となる。また、スプレー法とはカップリング剤液等を基板に向けてスプレー噴霧する方法であり、ディップ法とは基板をカップリング剤液等に浸漬する方法である。これらの方法によれば、特殊な装置を必要とせず、簡便な工程で膜を形成することができる。また気相法とは、基板を必要に応じて加熱し、ここにカップリング剤液等の蒸気を流動させる方法である。この方法によっても膜厚の薄い膜を膜厚制御性良く形成することができる。このうち、シランカップリング剤溶液をスピncコートする方法が好ましく用いられる。優れた密着性が安定的に得られる。

【0089】

この際、溶液中のシランカップリング剤濃度は、好ましくは0.01～5 v/v%、より好ましくは0.05～1 v/v%とする。シランカップリング剤溶液の溶媒としては、純水；メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等のアルコール；酢酸エチル等のエステル類等を単独または2種以上を混合して使用できる。このうち、純水で希釈したエタノール、メタノール、および酢酸エチルが好ましい。密着性の向上効果が特に顕著となる。

【0090】

カップリング剤液等を塗布した後は、乾燥を行う。乾燥温度は特に制限はないが、通常、室温（25℃）～170℃の範囲で行う。乾燥時間は、温度にもよるが、通常は0.5～24時間とする。乾燥は空気中で行ってもよいが、窒素等の不活性ガス中で乾燥させてもよい。例えば、窒素を基板に吹き付けながら乾燥させる窒素ブロー法を用いることもできる。

【0091】

また、カップリング剤膜の作製方法として、“Nature, vol. 403, 13, January(2000年)”に記載されているように、LB膜引上げ法により基板全面にシランカップリング剤からなる膜を形成し、親水性／疎水性のマイクロパターンを形成することができる。

さらに、この疎水性処理はスタンプやインクジェットなどの印刷技術を用いて行うこともできる。

【0092】

スタンプによる方法では、PDMS樹脂を用いる。PDMS樹脂はシリコンオイルを

重合して樹脂化するが、樹脂化した後も分子間隙にシリコンオイルが充填された状態となっている。そのため、PDMS樹脂を親水性の表面、例えば、ガラス表面に接触させると、接触した部分が強い疎水性となり水をはじく。これを利用して、流路部分に対応する位置に凹部を形成したPDMSブロックをスタンプとして、親水性の基板に接触させることにより、上記の疎水性処理による流路に設けられた堰き止め部が簡単に製造できる。

【0093】

インクジェットプリントによる方法では、粘調性が低いタイプのシリコンオイルをインクジェットプリントのインクとして用い、流路の堰き止め部に相当する壁部分にシリコンオイルが付着するようなパターンに印刷することによっても同じ効果が得られる。

(実施形態3)

図18は、本実施形態の制御構造の構成を示す部分断面図である。

【0094】

本実施形態は、図1に示す構成からなる制御構造と基本的には同じ構成であるが、堰き止め部104が、第一の流路と第二の流路とを隔てる隔壁1104に設けられた複数の連通流路を備え、さらに第一の液体に対する疎液性が第一の流路よりも高い疎液性ふた180を備える点で構成が異なる。

【0095】

なお、図18には示さないが、堰き止め部104以外の、第一の流路101および第二の流路102は、ともに親液性ふたを備えている。また、第一の流路101および第二の流路102が形成されている基板1166の表面も親液性である。

【0096】

このような構成により、第一の液体を第一の流路101方向に押し戻す方向に働く毛細管力が大きくなるため、第二の流路102に液体が存在しない場合には、第一の液体は表面張力により押し戻され、堰き止め部104の途中で停止するため、堰き止め部104にて第一の液体を堰き止めることができる。

【0097】

なお、この場合、第一の液体が水溶液である場合には、上記の疎液性ふたは、その水溶液に対する疎水性が第一の流路よりも高い疎水性ふたとすることができる。また、第一の流路101および第二の流路102が形成されている基板1166の表面も親水性とすることができる。

図19は、本実施形態の制御構造の構成の一例を示す部分平面図である。

【0098】

親水性の材料からなる被覆（ふた）を使用する場合、図18（a）のように、第一の流路101に水溶液を導入すると、隔壁1104に設けられた開口部が広すぎる場合などには、隔壁1104に設けられた多数の開口部を介して第二の流路102にもその水溶液が速やかに浸入してしまう場合がある。隔壁1104の部分でこの水溶液を堰き止めるには、この開口部を狭くすることが有効である。しかし、開口部を狭くしすぎると、制御構造が開状態となった場合に、制御構造の液体流量が少なくなってしまう場合がある。

【0099】

一方、疎水性材料からなる被覆（ふた）1180を用いる制御構造においては、以下のような現象が生じることを本発明者らは見出した。すなわち、図19（b）において、第一の流路101に水溶液を導入すると、隔壁1104に設けられた開口部が図19（a）と同程度に広い場合などにも、水溶液は第二の流路102に浸入することなく、第一の流路101に留まる場合がある。さらに、この状態で第二の流路102から別の水溶液などを流すと、隔壁1104に設けられた開口部を介して、第一の流路101および第二の流路102内の液体が接触する。その結果、制御構造が開状態となり、第一の流路101内の水溶液が第二の流路102内に浸入できるようになる。

【0100】

上記のような構成を備える制御構造によれば、制御構造の上部に疎水性の被覆1180を備えるため、ある程度広い開口部を多数備える隔壁1104によっても、第一の流路1

01内の水溶液を堰き止めることができる。その結果、開通状態になった場合には制御構造内を通過する水溶液の流量を大きくすることができる。

【0101】

この場合の疎水性の被覆1180の材料としては、ポリジメチルシロキサン(PDMS)、ポリカーボネート、ポリスチレンなどの疎水性樹脂が例示される。また、疎水性の材料を用いた被覆1180の他、例えば図18(b)のように、被覆1180の表面にキシレンシラザンなどの疎水性コーティング剤により疎水性のコート層1180aを設けたものを被覆とすることもできる。

【0102】

ここで、上述の開口部による液体の堰き止め、あるいは通過を可能とする液体の制御を実現するためには、被覆1180の疎水性の度合いについて、開口部の径に応じた選択をすることが有効である。

【0103】

例えば、開口部の径が $50\mu\text{m}$ 以上と比較的大きい場合、極めて疎水性の度合いが高い材料であるPDMSからなる被覆1180を用いても、第二の流路102内に水溶液がなければ、第一の流路101内の水溶液は堰き止められ、第二の流路102内に水溶液があれば、第一の流路101内の水溶液は二の流路102内に浸入する。

【0104】

しかし、開口部の径が $1\mu\text{m}$ 以下と小さい場合、PDMSからなる被覆1180からなる被覆1180を使用すると、第二の流路102内に水溶液があっても、第一の流路101内の水溶液は二の流路102内に浸入しない。

【0105】

この場合、被覆1180の材料として、疎水性の度合いがPDMSよりも低いポリカーボネートを選択することにより、第二の流路102内に水溶液があれば、第一の流路101内の水溶液は二の流路102内に浸入することができる。

(実施形態3)

図2は、本実施形態の制御構造の構成を示す平面図である。

【0106】

本実施形態において、堰き止め部104は、第一の流路101の単位体積あたり表面積よりも大きい単位体積あたり表面積を有する構成としている。この堰き止め部104は、具体的には、第一の液体の保持部材として、多孔質体やビーズが充填された構成とする。

【0107】

このような構成によっても、第一の液体を第一の流路101方向に押し戻す方向に働く毛細管力が大きくなる。そのため、第二の流路102に液体が存在しない場合には、堰き止め部104にて第一の液体を堰き止めることができる。

【0108】

この構成では、堰き止め部104において、流路の他の部分よりも単位体積あたり表面積(液体が存在する場合には、この表面は固液界面として機能する)が大きくなるように構成されている。このような構成とする場合、多孔質体やビーズは、これらを流路の所定箇所に直接充填、接着することにより形成することができる。

【0109】

図2(a)は、本実施形態において、第一の流路101と、第二の流路102とが、互いに略反対の方向から伸びてきて堰き止め部104の近傍で並行となる構成において、第一の流路101の左から第一の液体を導入した場合の模式図である。このとき、進行方向の第二の流路102には、液体は導入されていない。

【0110】

このような制御構造を設けることにより、第一の液体の流れを一方通行にすることができる。この一方通行の向きは、進行方向側の第二の流路102内に溶液が存在するかどうかで定まる。すなわち、流路の他の部分よりも単位体積あたり表面積(液体が存在する場合には、この表面は固液界面として機能する)が大きい多孔質体からなる堰き止め部10

4があるので、毛細管効果で第一の液体は堰き止め部104の先端まで進むが、この先端の液面においては堰き止め部104による毛細管力が第一の液体を第一の流路101方向に押し戻す方向に働くため、第二の流路102に進入することなく停止してしまう。すなわち、図2(a)は、本実施形態の制御構造のいわゆる閉状態を示す。

【0111】

図2(b)では、あらかじめ進行方向である第二の流路102内に第二の液体が導入されている。このとき第一の流路101の左側から第一の液体を導入すると、毛細管効果で第一の液体は堰き止め部104の先端まで進んだ第一の液体は、堰き止め部104の反対側に液体が存在するため、第二の液体と第一の液体とが互いに接触する。

【0112】

すると、堰き止め部104における第一の液体の第二の流路102内への進入を抑制する方向の毛細管力がいずれも消失または著しく減殺することとなるか、あるいは第二の液体に加わる毛細管力により相殺されるので、第一の液体は第一の液体に加わる通過圧力により第二の流路102内に進入する。なお、第一の液体に加わる通過圧力は、第二の液体に加わる通過圧力よりも大きいものとする。すなわち、図1(B)は、本実施形態の制御構造のいわゆる開状態を示す。

【0113】

この一方通行効果を利用することで、第一の液体の逆流を抑制し、混合が不要な溶液同士の混合を抑制することができる。そのため、後述するように、この制御構造104を用いることで、アフィニティーカラムの洗浄などの際に洗浄液の逆流を抑制することができる。

(実施形態4)

図3は、本実施形態の制御構造の構成を示す平面図である。

【0114】

本実施形態において、堰き止め部104は、単数または複数の突起部を備える構成とする。この堰き止め部104は、具体的には、複数の柱状体が設けられた構成、離間して配置された複数の突起部を備える構成などからなる堰き止め部104に備わる構成とする。なお、図3では、多数の柱状体が設けられた構成を例示している。流路を構成する外壁4101と、柱状体4105と、が図示されている。

図4は、本実施形態の制御構造の構成を別の角度から示す図である。

【0115】

図4(a)には、流路を構成する外壁4101と、柱状体4105と、第一の流路101と、第二の流路102と、堰き止め部104内に設けられた柱状体4105の集合部位4107と、が平面図として図示されている。

【0116】

図4(b)は、図4(a)に示す制御構造のA-A'線における断面図である。流路を構成する外壁4101と、柱状体4105と、堰き止め部104内に設けられた柱状体4105の集合部位4107と、が図示されている。堰き止め部104においては、流路中に柱状体4105が等間隔で規則正しく配設されており、柱状体4105の間を液体が流れる構成となっている。あるいは、この柱状体4105は、ランダムな間隔により配設されていてもよく、パッチ状の集合領域を形成するように配設されてもよい。

【0117】

このような構成によっても、堰き止め部104において、流路の他の部分よりも固液界面が大きくなる。そのため、第一の液体を第一の流路101方向に押し戻す方向に働く毛細管力が大きくなる。その結果、第二の流路102に液体が存在しない場合には、堰き止め部104にて第一の液体を堰き止めることができる。

【0118】

図5は、本実施形態の制御構造の構成の斜視図である。図5において、Wは流路の幅、Dは流路の深さを示し、 ϕ (ファイ) は柱状体4105の直径、dは柱状体4105の高さ、pは隣接する柱状体4105間の平均間隔を示す。流路を構成する外壁4101も図

示されている。これらの要素を当業者が適宜調整して設計することにより、堰き止め部 104 において、流路の他の部分よりも固液界面を大きくすることができる。そのため、第一の液体を第一の流路 101 方向に押し戻す方向に働く毛細管力が大きくなる。その結果、第二の流路 102 に液体が存在しない場合には、堰き止め部 104 にて第一の液体を堰き止めることができるようになる。

【0119】

あるいは、これらの単数または複数の突起部の表面を疎液処理して、第一の液体に対する疎液性が第一の流路よりも高い疎液性を備える構成とすることもできる。

【0120】

図 6 は、本実施形態の制御構造に備わる柱状体の表面の構成を示す図である。堰き止め部 104 の流路を構成する外壁 4101 および柱状体 4105 の表面には、疎液層 4109 が形成されている。すなわち、この堰き止め部 104 は疎液処理されている。

【0121】

このような構成によっても、第一の液体を第一の流路 101 方向に押し戻す方向に働く毛細管力が大きくなる。そのため、第二の流路 102 に液体が存在しない場合には、堰き止め部 104 にて第一の液体を堰き止めることができる。

【0122】

このような構成とする場合、複数の柱状体が設けられた構成、離間して配置された複数の突起部を備える構成などからなる堰き止め部 104 は、基板上に設ける場合には、基板の種類に応じて適宜な方法で形成することができる。

【0123】

具体的には、石英基板やシリコン基板を用いる場合、フォトリソグラフィ技術およびドライエッチング技術を利用して形成することができる。プラスチック基板を用いる場合、形成しようとする柱状体などのパターンの反転パターンを有する金型を作製し、この金型を用いて成形を行い所望の形状からなる堰き止め部 104 を得ることができる。なお、このような金型は、フォトリソグラフィ技術およびドライエッチング技術を利用することにより形成することができる。

図 8 は、本実施形態の制御構造の製造途中の断面図である。

【0124】

本実施形態に係る単数または複数の突起部を備える構成からなる堰き止め部の製造方法について説明する。

【0125】

まず、図 8 (a) に示すように、例えば、支持体 8201 上に堰き止め部 104 の底面材料 8202、堰き止め部 104 の柱状体材料 8203 を CVD 法などによりこの順で形成する。底面材料 8202、柱状体材料 8203 の膜厚は当業者により適宜設計される。次に、図 8 (b) に示すように、柱状体材料 8203 をフォトリソグラフィ技術およびドライエッチング技術などによりパターンニングする。続いて、図 8 (c) に示すように、同様に側面材料 8205 を形成し、図 8 (d) に示すように、同様にパターンニングする。以上のプロセスにより、図 4 (a) に示す制御構造が作製される。なお、上記のプロセスの後、適宜、疎液性を付与するための表面処理等を行ってもよい。

【0126】

このようなプロセスにより、本実施形態の制御構造を、半導体技術分野の一般的な微細加工技術を用いて、精度よく形成することができる。

(実施形態 5)

図 20 は、本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す部分概略図である。

【0127】

上記実施形態では、複数の連通流路が形成された隔壁を有する構成や、単数または複数の突起部を備える構成からなる制御構造を示した。本実施形態では、これらとは異なる土手型の構成からなる制御構造を示す。

【0128】

本実施形態においては、第一の流路と第二の流路とを連通する堰き止め部の底面上に第一の流路と第二の流路とを分割するように土手部が設けられ、この土手部の高さが第一の流路と第二の流路との深さよりも低い構成となっている。

【0129】

図20の分図(a)、(b)はそれぞれ断面図、斜視図である。図20(a)に示されるように、基板1166には第一の流路101、第二の流路102が設けられ、それらを分けるようにして土手部(隔壁)1165が設けられている。基板1166の上には被覆1180が配設される。便宜上、被覆1180は図20(b)には示していない。

【0130】

図20(a)から分かるように、隔壁1165と被覆1180との間には空間が確保されているため、この空間を介して第一の流路101および第二の流路102は互いに連通している。この空間は、上記実施形態の制御構造における隔壁に設けられた連通路に相当する。この場合、被覆1180には、ポリジメチルシロキサンやポリカーボネートなどの疎水性材料からなるものを選択することが有効である。

【0131】

このようにすることにより、例えば第一の流路101に水溶液を流し、第二の流路102には別の水溶液が存在しない場合には、第一の流路101内の水溶液はこの土手部1165において堰き止められる。また、第二の流路102内に別の水溶液が存在する場合には、第一の流路101内の水溶液はこの土手部1165を超えて、第二の流路102に浸入する。

【0132】

本実施形態の制御構造は、第一の流路101および第二の流路102を、上記実施形態の制御構造に比較して広い面積で接続する。そのため、開通状態における流量を大きくすることができるという利点を有している。また、細長い物質であっても詰まりにくく、流路間を容易に移動できる。そのため、こうした物質を含む液体の通過の制御に好適に用いることができる。

【0133】

このような第一の流路101、第二の流路102および隔壁1165は、例えば(100) Si基板をウェットエッチング処理することにより得られる。(100) Si基板を用いた場合、(001)方向に直交あるいは平行な方向では、図示されるように台形型にエッチングが進行する。そのため、エッチング時間を調節することにより隔壁1165の高さを調節することが可能である。

【0134】

また、図21に示されるように、隔壁1165dを被覆1180上に設けることもできる。このような隔壁1165dを備えた被覆1180は、ポリスチレンなど樹脂を射出成形することにより容易に得ることが可能である。また、基板1166には、1本の流路をエッチング等により設けるだけでよい。したがって、この分離装置は上記のような簡便なプロセスにより得られるため、大量生産に適している。

(実施形態6)

図28は、本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す概略図である。

【0135】

本実施形態の制御弁は、フォトリソグラフィーの技術を応用することにより製造することもできる。具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジストや光硬化性樹脂などを塗布し、図28(a)、図28(b)、図28(c)に示すようなパターンを形成することにより、本実施形態の制御弁を形成することができる。

【0136】

このようなフォトレジストとしては、例えばMicroposit(R) S1805フォトレジスト(Shipley Company, Inc. 製)を用いることができる。

【0137】

このS1805の表面に対する水滴の接触角は約80度であり、S1805を塗布しないガラス基板表面（またはS1805を除去したガラス基板表面）に対する水滴の接触角は約40度である。そのため、本実施形態の制御弁の機能を達成するのに十分な親水性・疎水性の差を得ることができる。

【0138】

図28(a)、図28(b)、図28(c)は、本実施形態の制御構造の平面構造図である。これらの図においては、斜線を施した領域が親水性の領域（S1805を塗布しないガラス基板表面またはS1805を除去したガラス基板表面）であり、水溶液の流路を形成する。また、空白の領域は疎水性の領域（S1805を塗布した表面）であり、水溶液の流路の外枠や堰き止め部などを形成することとなる。

【0139】

すなわち、これらの制御構造は、水溶液の通る第一の流路101と、この第一の流路101に連通し、この水溶液を堰き止める堰き止め部104と、別の水溶液をこの堰き止め部104に導く第二の流路102と、を備え、この第一の流路101からこの第二の流路102へのこの水溶液の通過を制御する制御構造である。そして、この堰き止め部104は、この水溶液に対する疎水性がこの第一の流路101よりも高い領域を備える。

【0140】

このような構成により、この水溶液を第一の流路101方向に押し戻す方向に働く毛細管力が大きくなる。そのため、第二の流路102に別の水溶液が存在しない場合には、この水溶液は表面張力により押し戻され、堰き止め部104の途中で停止する。その結果、堰き止め部104にてこの水溶液を堰き止めることができる。

【0141】

具体的には、本実施形態の制御構造は、図28(a)、図28(b)、図28(c)に示すように、2つの流路が狭い疎水性領域で隔てられている。この疎水性領域の幅は、両側の流路から張り出せる水溶液のメニスカスが融合できる程度に狭くする。

【0142】

ここで、2つの流路の一方だけに水溶液を導入すると、疎水性部分で水溶液は停止する。一方、反対側の流路に、既に水溶液が導入されている場合には、水溶液のメニスカス同士が融合して2つの流路が開通する。

【0143】

また、後述する本実施形態のグラディエント形成装置に用いる液体スイッチなども、本実施形態の制御弁と同様に、フォトリソグラフィの技術を応用することにより製造することができる。

【0144】

具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジストや光硬化性樹脂などを塗布し、図28(d)、図28(e)に示すようなパターンを形成することにより、液体スイッチを形成することができる。

【0145】

この液体スイッチは、図28(d)に示すように、横に伸びる主流路（第一の流路801および第二の流路802からなる）が、縦に伸びるトリガー流路803と交叉しており、トリガー流路803の片側に疎水性領域からなる堰き止め部804が設けられ、主流路を仕切っている。

【0146】

このような構成により、第一の流路101に水溶液を導入した場合、トリガー流路803に水溶液があると、水溶液のメニスカス同士の融合で主流路が開通することになる。

【0147】

あるいは、この液体スイッチは、図28(e)に示すように、トリガー流路803の両側に疎水性領域からなる第一の堰き止め部805および第二の堰き止め部806が設けられてもよい。

【0148】

このような構成によれば、この液体スイッチは、本実施形態の制御構造の機能を併せ持つことになる。すなわち、第一の流路101に水溶液を導入した場合、トリガー流路803と、さらに反対側の第二の流路102にも水溶液があるときだけ、主流路が開通することになる。

【0149】

これらの平面構造は、水溶液を処理する場合の構造であるが、本実施形態の制御構造は特に水溶液の制御に限られるものではない。すなわち、第一の液体が油性溶媒などからなる場合には、上記の平面構造の親水性領域を親油性領域に置き換え、疎水性領域を疎油性領域に置き換えて用いれば、同様の作用効果を得ることができる。

(実施形態7)

図9は、本実施形態の制御構造を備える装置を示す図である。

本実施形態の装置は、複数の流路と、上記の制御構造と、を備える装置である。

【0150】

ここで、この装置は、この装置中の流路を流れる試料液中の特定物質を分離する分離部をさらに備えることができる。この分離部としては、特定物質と選択的に吸着または結合する被吸着物質の層を備えることにより試料液中の特定物質を分離することができれば特にアフィニティーカラムに限られず、例えば、ゲルろ過クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水性クロマトグラフィー、逆相クロマトグラフィーなどに用いられるカラムなども用いることができる。

【0151】

分離部の構成は特に限定されないが、例えば、流路中に柱状体が略等間隔で規則正しく形成されており、柱状体の間隙を液体が流れる構成であって、かかる柱状体の表面に特定物質に対する被吸着物質層が形成されてなる構成などを用いることができる。かかる構成によれば、試料液体中の特定成分が柱状体の表面において被吸着物質と選択的に吸着または結合することが可能だからである。

【0152】

かかる柱状体は、例えば、基板を所定のパターンの形状にエッチングすることにより形成することができるが、その作製方法には特に制限はない。また、柱状体の形状は円柱、擬円柱等に限らず、円錐、楕円錐等の錐体、三角柱、四角柱等の多角柱、その他の断面形状を有する柱状体としてもよい。

【0153】

ここで、被吸着物質層に備える被吸着物質Aと特定物質A'とは、選択的に吸着または結合する組合せから選択される。このような組合せとしては、例えば、

- (a) リガンドとレセプター
- (b) 抗原と抗体
- (c) 酵素と基質、酵素と基質誘導体、または酵素と阻害剤
- (d) 糖とレクチン
- (e) DNA (デオキシリボ核酸) とRNA (リボ核酸)、またはDNAとDNA
- (f) タンパク質と核酸
- (g) 金属とタンパク質

【0154】

の組合せを用いることができる。それぞれの組合せにおいて、任意の一方が特定物質となり、他方が吸着物質となる。

【0155】

本実施形態の装置を、特定物質の分離装置として用いる場合には、具体的には、試料液中の特定物質を分離する分離部206と、上記の制御構造204と、試料液201の導入部203と、洗浄液202の導入部203と、特定物質の脱離液210の導入部102と、を備え、制御構造204は、分離部206と上記の第一の流路101を介して連通し、試料液201の導入部203および洗浄液202の導入部203は、上記の第一の流路1

01に、制御構造204と分離部206との間で連通し、脱離液210の導入部102は、制御構造204に上記の第二の流路102を介して連通する分離装置とする。

【0156】

このような構成により、第一の流路101または第二の流路102に溶液が存在しない場合には、一方の流路内の液体は制御構造204を超えることは無いため、制御構造204を超えて液体が逆流することがない。また、分離部206に試料液201中の特定物質を取り込ませて、分離部206を洗浄液により洗浄した後、脱離液210により分離部206から特定物質を脱離させることにより、特定物質を精度よく分離することができる。

【0157】

なお、この装置は、より具体的には、第一の流路101の途中にアフィニティーカラム206を備える装置とすることができる。第一の流路101の途中には、サンプル201と洗浄液202を導入するための第三の流路203が設けられ、第一の流路101の端には廃液溜208が設けられている。アフィニティーカラム206には、リセプタータンパク質がカップリング剤を利用して結合されてもよい。なお、検出部、採取部は特に示していないが、アフィニティーカラム206と廃液溜208の間に設けることができる。

【0158】

このような構成とすることにより、第一の流路101または第二の流路102に溶液が存在しない場合には、一方の流路内の液体は制御構造204を超えることは無いため、制御構造204を超えて液体が逆流することがない。また、アフィニティーカラム206に上記のリセプタータンパク質と結合または吸着する基質が存在すれば、試料液中のその基質をリセプタータンパク質に結合または吸着させて、アフィニティーカラム206を適当な洗浄液により洗浄した後、上記のリセプタータンパク質と基質とを脱離させる脱離液210によりアフィニティーカラム206から基質を脱離させることにより、上記の基質を精度よく分離して、検出、採取することができる。

【0159】

本実施形態の装置は、後述するように、マイクロチップ上でアフィニティークロマトグラフィーをはじめとする各種クロマトグラフィーを行うことができる。そのため、 μ TAS (Micrototal Analytical System: マイクロトータル・アナリティカル・システム) に組み込むことも可能になる。例えば、分離部により分離された試料を試料乾燥部に連通する構成とすることにより、分離した試料を乾燥させて回収し、また質量分析等に供することが可能となる。

(実施形態8)

【0160】

次に、この制御構造を備える装置を利用した上記のアフィニティークラムの洗浄方法について図9を参照しながら説明する。

【0161】

本実施形態の洗浄方法は、上記の分離装置の洗浄方法であって、上記の洗浄液の導入部に洗浄液を導入し、上記の第一の流路にこの洗浄液を流入させ、上記の分離部をこの洗浄液で洗浄するステップを備える洗浄方法である。

【0162】

このようなフローによれば、上記の制御構造が第一の液体を堰き止める堰き止め部を備えるため、第二の流路内に液体が存在しない場合には、第一の流路から第二の流路への第一の液体の通過が堰き止め部により堰き止められる。そのため、この洗浄液は、制御構造を超えて逆流することがない。

【0163】

具体的には、まず、アフィニティークラム206にサンプル201中のリガンドを結合させるために第三の流路203からサンプル201を導入する。この時、第二の流路102には溶液が存在しないためサンプル201は制御構造204を超えることは無い。リガンドがアフィニティークラム206に結合した後、第三の流路203に洗浄液202を導入する。同様に制御構造204を超えて逆流することなく、アフィニティークラム206

が洗浄できる。このとき、この制御構造 2 0 4 はいわゆる逆止弁として機能している。

【0 1 6 4】

このような方法により、第一の流路 1 0 1 または第二の流路 1 0 2 に溶液が存在しない場合には、一方の流路内の液体は制御構造 2 0 4 を超えることは無い。そのため、制御構造 2 0 4 を超えて液体が逆流することがない。

(実施形態 9)

次に、この制御構造を備える装置を利用した特定物質の分離方法について図 9 を参照しながら説明する。

【0 1 6 5】

本実施形態の特定物質の分離方法は、上記の分離装置による特定物質の分離方法であって、上記の試料液の導入部に試料液を導入し、上記の第一の流路に試料液を流入させ、上記の分離部にこの特定物質を取り込ませるステップと、この洗浄液の導入部に洗浄液を導入し、この第一の流路にこの洗浄液を流入させ、この分離部をこの洗浄液で洗浄するステップと、上記の脱離液の導入部に脱離液を導入し、上記の第二の流路および上記の制御構造を介してこの脱離液をこの第一の流路に流入させ、この特定物質をこの分離部から脱離させるステップと、を備える分離方法とすることができる。

【0 1 6 6】

このようなフローによれば、この洗浄液は、制御構造の反対側の流路に液体が存在しない場合には、制御構造を超えて逆流することがない。また、分離部に試料液中の特定物質を取り込ませて、分離部を洗浄液により洗浄した後、脱離液により分離部から特定物質を脱離させることにより、特定物質を精度よく分離することができる。

【0 1 6 7】

具体的には、まず、アフィニティーカラム 2 0 6 にサンプル 2 0 1 中のリガンドを結合させるために第三の流路 2 0 3 からサンプル 2 0 1 を導入する。この時、第二の流路 1 0 2 には溶液が存在しないためサンプル 2 0 1 は制御構造 2 0 4 を超えることは無い。リガンドがアフィニティーカラム 2 0 6 に結合した後、第三の流路 2 0 3 に洗浄液 2 0 2 を導入する。同様に制御構造 2 0 4 を超えて逆流することなく、アフィニティーカラム 2 0 6 が洗浄できる。このとき、この制御構造 2 0 4 はいわゆる逆止弁として機能している。

【0 1 6 8】

次に、第二の流路 1 0 2 に、例えばリガンドの抽出用の塩溶液などの脱離液 2 1 0 を導入すると、進行方向の第一の流路 1 0 1 には既に洗浄液 2 0 2 がある。そのため、この脱離液 2 1 0 は制御構造 2 0 4 を超えてアフィニティーカラム 2 0 6 へと至り、アフィニティーカラム 2 0 6 から特定物質を脱離させ、所望の分離・抽出結果が得られる。

【0 1 6 9】

このような方法により、第二の流路 1 0 2 に液体が存在しないときには、サンプル 2 0 1 または洗浄液 2 0 2 は制御構造 2 0 4 を超えて第二の流路に進入することがない。一方で第二の流路 1 0 2 に導入された脱離液 2 1 0 は、第一の流路 1 0 1 にすでに液体が存在する。そのため、制御構造 2 0 4 を超えて第一の流路 1 0 1 に進入することができる。このような構成の場合、制御構造 2 0 4 は一種の逆止弁として機能している。また、上記の制御構造を逆止弁として機能させることができる。そのため、不要な液体同士の混合が起らず、特定物質を分離部において精度良く分離することができる。

(実施形態 1 0)

図 1 1 は、本実施形態のグラディエント形成装置を示す概略図である。

【0 1 7 0】

本明細書において、グラディエント形成装置とは、2 種類以上の組成の液体を混合することにより、濃度勾配（グラディエント）を有する液体を形成する装置を意味する。2 種類以上の液体としては、特に限定する趣旨ではないが、塩溶液とバッファー溶液との組合せなどがあり得る。

【0 1 7 1】

本実施形態のグラディエント形成装置は、図 1 1 に示すように、第一の組成液が流れる

順流路 4 0 5 と、順流路 4 0 5 と並行し、第二の組成液が流れる逆流路 4 0 4 と、この順流路 4 0 5 に連通するように設けられ、この第一の組成液の原液をこの順流路 4 0 5 に導入する第一の導入部 4 0 1 と、この順流路 4 0 5 の下流側でこの逆流路 4 0 4 に連通し、この第二の組成液の原液をこの逆流路 4 0 4 に導入する第二の導入部 4 0 2 と、この順流路 4 0 5 とこの逆流路 4 0 4 とを隔て、この第一の組成液またはこの第二の組成液の少なくともこの特定成分が通過可能な隔壁 4 0 6 と、この順流路 4 0 5 の下流側でこの順流路 4 0 5 に連通し、この特定成分が濃度勾配を示すこの第一の組成液を採取するグラディエント液採取部と、を備えるグラディエント形成装置とすることができる。

【0172】

このような構成により、第一の組成液と第二の組成液が対向流を形成しながら成分の交換を行う。そのため、特別な外部制御手段なしに経時的な濃度勾配を有するグラディエント液を得ることができる。

【0173】

ここで、このグラディエント形成装置は、この順流路 4 0 5 およびこの逆流路 4 0 4 が基板上に流路溝として形成されてもよい。例えば、本実施形態のグラディエント形成装置は、石英基板表面に溝部からなる流路などを形成することにより作製することができる。なお、一般に石英基板の表面は親水性であるので、この溝部内壁は親水性表面となっている。

【0174】

このような構成を備えることにより、本実施形態のグラディエント形成装置をオンチップで他の装置などと一緒に作り込むことができる。そのため、本実施形態のグラディエント形成装置を小型化することができる。また、半導体装置の技術分野などで利用されている微細加工技術を応用することにより、微細な構造からなるグラディエント形成装置を精度よく作製することができる。

【0175】

また、この隔壁 4 0 6 は、この順流路 1 6 1 b およびこの逆流路 1 6 1 a に連通する複数の流路を備える構成とすることができる。

【0176】

図 1 2 は、本実施形態のグラディエント形成装置の隔壁の構成を示す拡大平面図である。このように、順流路 1 6 1 b と逆流路 1 6 1 a との間にこの順流路 1 6 1 およびこの逆流路 1 6 1 a に連通する複数の流路を備える隔壁 1 6 5 が設けられる構成とすることができる。

【0177】

図 1 3 は、本実施形態のグラディエント形成装置の隔壁の構成を示す斜視図である。このように、基板 1 6 6 上の順流路 1 6 1 b と逆流路 1 6 1 a との間にこの順流路 1 6 1 およびこの逆流路 1 6 1 a に連通する複数の流路を備える隔壁 1 6 5 が設けられ、順流路および逆流路の幅は W であり、隔壁の長さは L であり、隔壁の幅は d_2 であり、複数の流路の幅は d_1 である構成とすることができる。

【0178】

このような構成とすることにより、第一の組成液と第二の組成液が対向流を形成しながら行う成分の交換の効率が向上する。そのため、特別な外部制御手段なしに得られる濃度勾配を有するグラディエント液がより均一な濃度勾配を有することとなる。また、複数の流路の数や幅や間隔などを当業者が適宜設計することにより、混合速度を調整することができる。そのため、所望の濃度勾配を有するグラディエント液を容易に得ることができる。

図 1 4 は、本実施形態のグラディエント形成装置によるグラディエント形成の様子を示す概念図である。

【0179】

上記のように、順流路 1 6 1 b と逆流路 1 6 1 a との間にこの順流路 1 6 1 b およびこの逆流路 1 6 1 a に連通する複数の流路を備える隔壁 1 6 5 が設けられる構成とするこ

とにより、順流路 161b 中の特定物質 151 の一部が複数の流路を介して対向流を形成する逆流路 161a に所定の流入割合で流入することにより、順流路 161b 中には、時間的または距離的に特定物質の濃度勾配が形成されたグラディエント液が形成される。この逆流路 161a 中の第二の組成液を枯渇させることにより、グラディエントが形成された第一の組成液を採取することができる。

【0180】

また、複数の流路は順流路または逆流路に対して略直角をなす直線状の形状であってもよいが、一方の流路側が他方の流路側よりも拡大して開口する形状とすることもできる。また、一方の流路側から他方の流路側に向けてテーパ状に形成された溝とすることもできる。このようにすれば、複数の流路が特定成分の逆流抑制弁としての機能を備えたものとなる。

【0181】

また、複数の流路は、一方の流路における流体の流れ方向に対して鋭角をなすように設けられ、他方の流路における流体の流れ方向に対して鈍角をなすように設けられた構成とすることもできる。ここで、「流路における流体の流れ方向に対して鋭角をなす」とは、複数の流路の開口部から複数の流路の形成された方向と、その複数の流路に満たされた液体の流れ方向（外力付与方向）とのなす角が鋭角であることをいう。また、「流路における流体の流れ方向に対して鈍角をなす」とは、複数の流路の開口部から複数の流路の形成された方向と、その流路に満たされた液体の流れ方向（外力付与方向）とのなす方向が鈍角であることをいう。このような構成を採用することにより、複数の流路が逆流抑制弁としての機能を有し、より好適にグラディエント液を得ることができる。

【0182】

あるいは、この隔壁は、このような直線状の複数の流路を備える構成に限定されるわけではなく、いわゆる平面限外濾過構造として機能し得る構成であれば任意の構成であってよく、例えば、複数の細穴を備える隔壁を含んでもよい。または、この隔壁 406 は、例えば、多数の柱状体が所定の間隔で配置された構成により実現することもできる。柱状体間の間隔が複数の流路となる。柱状体の形状は、円柱、楕円柱等、擬円柱形状；円錐、楕円錐、三角錐等の錐体；三角柱、四角柱等の角柱のほか、ストライプ状の突起等、さまざまな形状を含むことができる。また、複数の流路の幅や長さは、目的に応じて適宜設定される。

【0183】

このような微細な複数の流路は、微細加工用のレジストを用いた電子リソグラフィ技術などを利用することにより形成することができる。また、本実施形態において、流路や複数の流路はシリコン基板や石英などのガラス基板あるいはシリコン樹脂等の表面に形成することができる。これらの基板の表面に溝部を設け、これを表面部材によって封止することなどにより、流路や複数の流路を形成することができる。本実施形態における流路や複数の流路は、例えば基板を所定のパターン形状にエッチングすることにより形成することができるが、その作製方法は特に制限はない。

【0184】

あるいは、この隔壁 406 は、この特定成分を透過する半透膜を備える構成とすることもできる。このような構成とすることにより、第一の組成液と第二の組成液が対向流を形成しながら行う成分の交換の効率が向上するため、経時的または距離的な濃度勾配を有するグラディエント液がより均一な濃度勾配を有することとなる。

【0185】

例えば、この隔壁 406 が、第一の組成液に含まれる塩を第二の組成液の側に一定の透過速度で透過させる半透膜を含んでいれば、かかる半透膜を介して水分および塩を交換することができる、グラディエント液を好適に作成することができる。例えば、アガロース、セルロース、架橋デキストラン、ポリアクリルアミドなどの高分子の多孔質膜や多孔性ガラスなどを材質として用いることができる。

【0186】

このような構成を備えることにより、この第一の組成液（塩溶液など）またはこの第二の組成液（バッファー溶液など）の一部または全部の成分（塩や水分など）が適度な透過速度で通過可能な隔壁 406 を実現でき、特別な外部制御手段なしに経時的な濃度勾配を有するグラディエント液を得ることができる。

図 22 は、本実施形態のグラディエント形成装置の断面図である。

【0187】

図 22 (a) のグラディエント形成装置は、順流路 161b、逆流路 161a および複数の流路を有する隔壁 165 を備えた基板 166 と被覆 180 とからなっている。基板 166 については、上記で示したものと同様であるが、ここでは、被覆 180 に疎水性の材料を使用していることが特徴である。

図 23 は、本実施形態のグラディエント形成装置の平面図である。

【0188】

親水性の材料からなる被覆を使用する場合、図 23 (a) のように、一方の逆流路 161a にバッファーを導入すると、隔壁 165 に設けられた多数の開口部を介して他方の順流路 161b の流路にもそのバッファーが速やかに浸入してしまう。好適なグラディエントを形成するためには、この状態となる前に順流路 161b に塩溶液などを流す必要がある。そのため、バッファーと塩溶液などを同時に導入しなければならないが、このような操作は通常困難である。

【0189】

一方、疎水性材料からなる被覆 180 を用いる場合には、以下のような現象が生じることを本発明者らは見出した。すなわち、図 23 (b) において、一方の逆流路 161a にバッファーを導入すると、バッファーは他方の順流路 161b に浸入することなく、逆流路 161a に留まる。さらに、この状態で他方の順流路 161b から塩溶液などを流すと、隔壁 165 に設けられた開口部を介して、逆流路 161a および順流路 161b 内の液体が混和して、対向流の効果により好適なグラディエントが形成されることが判明した。

【0190】

上記のような性質を備えるこのグラディエント形成装置によれば、バッファーおよび塩溶液などを同時に導入するという困難な操作が不要となり、確実に好適なグラディエントが形成できるようになる。

【0191】

この場合、グラディエント形成装置の被覆 180 の材料としては、ポリジメチルシロキサン (PDMS)、ポリカーボネート、ポリスチレンなどの疎水性樹脂が例示される。また、疎水性の材料を用いた被覆 180 の他、例えば図 22 (b) のように、被覆 180 の表面にキシレンシラザンなどの疎水性コーティング剤により疎水性のコート層 180a を設けたものを被覆とすることもできる。

【0192】

ここで、上述の開口部を介して液体の混和によるグラディエントの形成を実現するためには、被覆 180 の疎水性の度合いについて、開口部の径に応じた選択をする必要がある。例えば、開口部の径が $50\ \mu\text{m}$ 以上と比較的大きい場合、極めて疎水性の度合いが高い材料である PDMS からなる被覆 180 を用いても上記混和が生じる。そのため、グラディエントを形成できる。

【0193】

しかし、開口部の径が $1\ \mu\text{m}$ 以下と小さい場合、PDMS からなる被覆 180 を使用すると上記混和が生じない。そのため、グラディエントが形成できない。この場合、被覆 180 の材料として、疎水性の度合いが PDMS よりも低いポリカーボネートを選択することにより、上記混和を生じさせることが可能である。そのため、グラディエントを形成できる。

【0194】

また、本実施形態のグラディエント形成装置は、図 11 に示すように、この逆流路 404 のこの隔壁 406 と接する領域の下流側に設けられた、この第二の組成液を堰き止める

堰き止め部409と、この堰き止め部409またはその下流側の箇所での逆流路404に連通し、この第一の導入部401またはその下流側の箇所での順流路405と連通し、この堰き止め部409へこの第一の組成液を導くトリガー流路408と、を備える液体スイッチ403をさらに備えるグラディエント形成装置としてもよい。

【0195】

このような構成により、第一の組成液と第二の組成液の流動開始のタイミングを同期するように制御することができる。そのため、第一の組成液と第二の組成液とが対向流を形成しながら行う成分の交換の効率が向上する。その結果、経時的または距離的な濃度勾配を有するグラディエント液がより均一な濃度勾配を有することとなる。また、第一の組成液と第二の組成液とが無駄に流れ去ることが減少するため、グラディエント形成に用いる溶液の量を減少させ、グラディエント形成装置をさらに小型化することができる。

【0196】

以下、本実施形態のグラディエント形成装置について、より具体的な例を挙げて説明する。図11は、オンチップでグラディエント液をつくるメカニズムの概略図である。ここでは、塩濃度が次第に高くなるグラディエント液を生成する場合を説明する。

【0197】

このグラディエント形成装置においては、基板上に、2本の流路として、順流路たるグラディエント流路405と、逆流路たるバッファ流路404とが掘られている。バッファ流路404の一端には、第二の組成液であるバッファの導入部に設けられたバッファを溜めるバッファ槽402が設けられ、他端にはそのバッファを排出する排出口とこの排出口からバッファを引き込んで溜める廃液溜407とが設けられている。

【0198】

グラディエント流路405の一端には、第一の組成液を導入する溶液導入部401と、そこから分岐した細い流路であるトリガー流路408が、バッファ流路404と廃液溜407とをつなぐ部分に設けられた液体スイッチ403に接続している。バッファ流路404とグラディエント流路405とは、グラディエント流路405およびバッファ流路404に連通する複数の流路を備える隔壁（いわゆる平面限外ろ過フィルタ構造）あるいは半透性の膜から成る隔壁406で仕切られている。

【0199】

なお、そのような隔壁は、壁の一方の流路だけが液体で満たされても壁の反対側に液体が進入することではなく、両側が液体で満たされると、両側の液体の成分が交換されることが、本発明者により実験的に確認されている。

【0200】

図11に示すように、本実施形態のグラディエント形成装置は、液体スイッチ403を備える。この液体スイッチ403は、スタンバイ状態（閉状態）またはオープン状態（開状態）となることができる。図中、主流路であるバッファ流路404の側面にトリガー流路408が接続している。

【0201】

トリガー流路408は、トリガー流路408内の親水性の程度やトリガー流路408径等を適宜に調整することによって、トリガー流路408内の液体の進行速度を調整することができる。これにより、液体スイッチ403動作の速度を調整できる。

【0202】

バッファ流路404とトリガー流路408との交差する領域の上流側（図中右上側）に堰き止め部409が設けられている。堰き止め部409は、流路の他の部分よりも強い毛細管力を有する部分となっている。堰き止め部409の具体的な構成としては、上記の実施形態の制御構造の堰き止め部104と同様の構成を好適に用いることができる。

【0203】

この液体スイッチ403の閉状態においては、バッファ流路404に導入されたバッファが堰き止め部409で保持される。この状態から所望のタイミングでトリガー液たる塩溶液がトリガー流路408を介して導入されると、塩溶液の液面の先端部分が前進し

、堰き止め部 409 と接触することとなる。

【0204】

この液体スイッチ 403 の閉状態においては、バッファは毛細管力により堰き止め部 409 に保持されているが、バッファが塩溶液と接触した状態になると、バッファが図中右方向（下流側）に移動し、バッファ流路 404 の下流側にバッファが流出して廃液溜 407 に流入する。すなわち、塩溶液が呼び水としての役割を果たし、液体スイッチ 403 としての動作が発現する。

【0205】

本実施形態のグラディエント形成装置において、第一の組成液または第二の組成液は、キャリア中に所定成分が溶解または分散した液体とする。キャリアは液体であるものとする。本実施形態の装置を、アフィニティークロマトグラフィーの脱離液としてのグラディエント液の作成に用いる場合には、キャリアとして、純水、純水と親水性溶媒の混合液、緩衝液等を用いることができる。具体的には、水とイソプロピルアルコールとの混合液、トリメチルアンモニウム、ホウ酸およびエチレンジアミン四酢酸（EDTA）を含む水溶液、リン酸ナトリウム水溶液、リン酸緩衝生理食塩水等が好適に用いられる。

【0206】

本実施形態のグラディエント形成装置において、流路の内部に充填される流体に外力を付与する外力付与手段をさらに備えた構成とすることもできる。外力付与手段の具体例としては、ポンプ、電圧印加手段等を例示することができる。外力付与手段は、各流路にそれぞれ設けても、複数の流路溝に対して一つ設けても良い。各流路にそれぞれ設けた場合は、各流路における流体の流れ方向をそれぞれ任意に変えることができ、これにより任意の混合性能をえることができる。

【0207】

もっとも、本実施形態においては、各流路に空気穴を設ければ、毛細管力により液体は自然に移動するので、外力付与手段を省いて構成を簡略にし、小型化、薄型化を実現するグラディエント形成装置を構成することもできる。

【0208】

上記本実施形態は、直線流路が平行に形成された例について説明したが、直線状のものに限らず、種々の形状の流路を採用することができる。

図 26 は、本実施形態のグラディエント形成装置の順流路および逆流路の構成の一例を示す図である。

【0209】

流路の壁 167 によって区画された対向流形成部は、順流路 161b および逆流路 161a が少なくとも特定成分を透過可能な隔壁 165 を介して並行して形成された構成となっている。逆流路 161a にはバッファの入り口 A および出口 A' が設けられ、順流路 161b には塩溶液の入り口 B および出口 B' が設けられている。

図 27 は、本実施形態のグラディエント形成装置の順流路および逆流路の構成の一例を示す図である。

【0210】

この構成でも、流路の壁 167 によって区画された対向流形成部は、順流路 161b および逆流路 161a が少なくとも特定成分を透過可能な隔壁 165 を介して並行して形成された構成となっている。逆流路 161a にはバッファの入り口 A および出口 A' が設けられ、順流路 161b には塩溶液の入り口 B および出口 B' が設けられている。

【0211】

これらの構成であっても、順流路 161b および逆流路 161a が少なくとも特定成分を透過可能な隔壁 165 を介して並行して形成された構成となっているため、対向流の効果により特定物質のグラディエントが形成されることに変わりはない。また、これらの構成によれば、少なくとも特定成分を透過可能な隔壁 165 の表面積を増大することが可能であるため、グラディエント形成装置をさらに小型化することが可能になる。

（実施形態 11）

図 24 は、本実施形態のグラディエント形成装置の隔壁の構成を示す概略図である。

【0212】

上記実施形態では、複数の流路が形成された隔壁を有するグラディエント形成装置を示した。本実施形態では、これらとは異なるグラディエント形成装置の一例を示す。

【0213】

本実施形態においては、上記の隔壁は土手部状の形状からなり、この土手部の高さが順流路および逆流路の深さよりも低い構成となる。

【0214】

具体的には、図 24 の分図 (a)、(b) はそれぞれ断面図、斜視図である。図 24 (a) に示されるように、基板 166 には順流路 161b、逆流路 161a が設けられ、それらを分けるように土手部 (隔壁) 165 が設けられている。基板 166 の上には被覆 180 が配設される。便宜上、被覆 180 は図 24 (b) には示していない。

【0215】

図 24 (a) から分かるように、隔壁 165 と被覆 180 との間には空間が確保されているため、この空間を介して順流路 161b および逆流路 161a は互いに連通している。この空間は、上記のグラディエント形成装置における隔壁に設けられた複数の流路に相当する。したがって、例えば逆流路 161a にバッファーを流し、順流路 161b に塩溶液を流すことにより、グラディエントを形成することができる。なお、この場合、被覆 180 にはポリジメチルシロキサンやポリカーボネートなどの疎水性材料からなるものを選択してもよい。このようにすることにより、各々の流路に、バッファーあるいは塩溶液を他の流路に浸入させることなく導入することができる。また、両方の流路に液体が満たされた段階で、上記空間を介して順流路 161b および逆流路 161a の混和を生じさせ、グラディエントを形成することができる。このような効果は、被覆 180 を取り付けない状態で操作実施することによっても得ることができる。このとき、空気自体が疎水性物質として上記被覆 180 と同様に機能しているものと考えられる。

【0216】

本実施形態のグラディエント形成装置は、順流路 161b および逆流路 161a を上記のグラディエント形成装置に比較して広い面積で接続する。そのため、より滑らかなグラディエントを形成できるという利点を有している。また、細長い物質であっても詰まりにくく、流路間を容易に移動できる。そのため、こうした特定物質のグラディエントを形成する際に好適に用いることができる。

【0217】

このような順流路 161b、逆流路 161a および隔壁 165 は、例えば (100) Si 基板をウェットエッチング処理することにより得られる。(100) Si 基板を用いた場合、(001) 方向に直交あるいは平行な方向では、図示されるように台形型にエッチングが進行する。そのため、エッチング時間を調節することにより隔壁 165 の高さを調節することが可能である。

【0218】

また、図 25 に示されるように、隔壁 165d を被覆 180 上に設けることもできる。このような隔壁 165d を備えた被覆 180 は、ポリスチレンなど樹脂を射出成形することにより容易に得ることが可能である。また、基板 166 には、1本の流路をエッチング等により設けるだけでよい。したがって、この分離装置は上記のような簡便なプロセスにより得られるため、大量生産に適している。

(実施形態 12)

図 29 は、本実施形態のグラディエント形成装置の隔壁の構成を示す概略図である。

【0219】

本実施形態のグラディエント形成装置の隔壁も、本実施形態の制御構造と同様に、フォトリソグラフィの技術を応用することにより製造することもできる。

【0220】

具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジス

トや光硬化性樹脂などを塗布し、図29に示すようなパターンを形成することにより、本実施形態のグラディエント形成装置の隔壁を形成することができる。

【0221】

このようなフォトレジストとしては、本実施形態の制御構造と同様に、例えばMicroposit (R) S1805 フォトレジスト (Shipley Company, Inc. 製) を用いることができる。

【0222】

図29においては、斜線を施した領域が親水性の領域 (S1805を塗布しないガラス基板表面またはS1805を除去したガラス基板表面) であり、水溶液の流路を形成する。また、空白の領域は疎水性の領域 (S1805を塗布した表面) であり、水溶液の流路の外枠や堰き止め部などを形成することとなる。

【0223】

具体的には、このグラディエント形成装置の隔壁901は、順流路903と逆流路905とを隔て、第一の組成液または第二の組成液の少なくとも特定成分が通過可能な隔壁911であり、この隔壁901は、順流路903および逆流路905に連通する複数の流路を備える。ここで、この複数の流路は、疎水性領域911の間に挟まれた構成となっている。なお、図29には、リザーバ部907a、907b、廃液溜909a、909bも記載されている。

【0224】

このような構成であっても、順流路903および逆流路905が少なくとも特定成分を透過可能な隔壁901を介して並行して形成された構成となっている。そのため、対向流の効果により特定物質のグラディエントが形成されることに変わりはない。

【0225】

この疎水性領域911の表面には水溶液が浸入しない。そのため、気泡が形成され、かかる気泡により複数の流路を備える隔壁901が形成される。この疎水性領域911のサイズと疎水性表面処理材料を適宜選択することにより、気泡のメニスカスサイズを調節して、第一の組成液と第二の組成液との混合速度を調節することができる。

【0226】

これらの平面構造は、水溶液を処理する場合の構造であるが、本実施形態のグラディエント形成装置の隔壁は特に水溶液の処理に限られるものではない。すなわち、第一の組成液が油性溶媒などからなる場合には、上記の平面構造の親水性領域を親油性領域に置き換え、疎水性領域を疎油性領域に置き換えて用いれば、同様の作用効果を得ることができる。

(実施形態13)

以下、本実施形態のグラディエント形成方法について、図11を参照して説明する。

【0227】

本実施形態のグラディエント形成方法は、上記のグラディエント形成装置により、特定成分が濃度勾配を示す液流を形成するグラディエント形成方法であって、この第二の導入部402に、この第二の組成液の原液を導入するステップと、この第一の導入部401に、この第一の組成液の原液を導入するステップと、このグラディエント液採取部より、この特定成分が濃度勾配を示すこの第一の組成液を採取するステップと、を備えるグラディエント形成方法とすることができる。

【0228】

このようなフローとすることにより、第一の組成液または第二の組成液の成分のうち少なくともこの特定成分が通過可能な隔壁406を介して、第一の組成液または第二の組成液に含まれる特定成分が交換されることにより、好適に特定成分のグラディエント液を作成することができる。また、逆流路404から第二の組成液を枯渇させることにより、グラディエント液をそのままグラディエント液採取部から採取することができる。

【0229】

さらに、本実施形態のグラディエント形成装置を用いるグラディエント形成方法につい

て、塩溶液の原液とバッファーの原液とを用いて塩のグラディエント液を形成する場合について、以下、より具体的に説明する。

【0 2 3 0】

例えば、まずバッファー槽 4 0 2 にバッファーを充填すると、バッファーは、毛細管効果により液体スイッチ 4 0 3 の部分まで進入して止まり、残りのバッファーはバッファー槽 4 0 2 にたまる。

【0 2 3 1】

次に、溶液導入部 4 0 1 に、先に充填したバッファーよりも充分に多い過剰量の塩溶液を導入する。塩溶液は、グラディエント流路 4 0 5 に進入すると同時に、液体スイッチ 4 0 3 のトリガー流路 4 0 8 にも進入し、液体スイッチ 4 0 3 を接続しバッファー流路 4 0 4 と廃液溜 4 0 7 がつながる。これにより、バッファー槽 4 0 2 内のバッファーが、廃液溜 4 0 7 の方向、すなわち塩溶液の流れる方向と対向する方向（対向流方向）へと流れ出す。

【0 2 3 2】

そして、塩溶液とバッファーとが対向流として流れる間、複数の流路を備える隔壁 4 0 6 中の複数の流路を通じて、塩溶液に含まれる塩がバッファー流路 4 0 4 へと拡散し、逆にバッファー中の水分が塩溶液へと浸透することによって、グラディエント流路 4 0 5 を進行する溶液の先端ほど塩濃度が薄く、塩溶液を導入する溶液導入部 4 0 1 に近いほど塩濃度が高い濃度グラディエントを有するグラディエント液がグラディエント流路 4 0 5 内に生成される。

【0 2 3 3】

この状態からバッファー槽 4 0 2 内のバッファーが枯渇し、バッファー流が停止すると対向流効果が消失する。溶液導入部 4 0 1 からバッファーよりも多く導入された塩溶液の流れに押される結果、先の塩濃度グラディエントを保った溶液がグラディエント流路 4 0 5 の先端から供給される。

【0 2 3 4】

なお、上記のような隔壁 4 0 6 は、隔壁 4 0 6 の一方の流路だけが液体で満たされても隔壁 4 0 6 の反対側に液体が進入することはない。そのため、グラディエント流路 4 0 5 内に形成されたグラディエント液がバッファー流路 4 0 4 内に溢れ出して失われることはない。

【0 2 3 5】

このようなフローとすることにより、塩溶液とバッファーに含まれる塩濃度が異なることとなる。そのため、隔膜を介して塩と水分が交換されることにより、好適にグラディエント液を作成することができる。なお、この塩濃度の差は大きいほど、グラディエントの傾きも大きくなる傾向があり、塩濃度の差は必要に応じて調整可能である。

【0 2 3 6】

また、このようなフローとすることにより、バッファー槽 4 0 2 内のバッファーが枯渇し、バッファー流が停止すると対向流効果が消失する。そのため、溶液導入部 4 0 1 からバッファーよりも多く導入された塩溶液の流れに押される。その結果、先の塩濃度グラディエントを保った溶液がグラディエント流路 4 0 5 の先端から供給される。

（実施形態 1 4）

【0 2 3 7】

本実施形態のマイクロチップは、基板と、この基板上に形成された上記の分離装置と、この基板上に形成された上記のグラディエント形成装置と、を備え、このグラディエント形成装置に含まれる上記のグラディエント液採取部は、この分離装置に含まれる上記の脱離液の導入部と連通するマイクロチップとすることができる。

【0 2 3 8】

このような構成により、本実施形態のマイクロチップは、上記の分離装置と上記のグラディエント形成装置の機能をワンチップ上で実現できる。すなわち、ワンチップ上でグラディエント液を脱離液として用いるクロマトグラフィーをワンチップ上で実現できる。

図 1 5 は、本実施形態のマイクロチップの一例を示す概略図である。

【0 2 3 9】

具体的には、本実施形態のマイクロチップに設けられたアフィニティークロマトグラフィー装置は、制御構造 2 0 4 を介して連通される第一の流路 1 0 1 と、第二の流路 1 0 2 とを備える。また、制御構造 2 0 4 は、第一の流路 1 0 1 と、第二の流路 1 0 2 との間に堰き止め部 1 0 4 を備え、第一の流路 1 0 1 は先端に空気穴を備える第一の開口部 1 0 6 a を備え、第二の流路 1 0 2 は先端に空気穴を備える第二の開口部 1 0 6 b を備える。

【0 2 4 0】

さらに、第一の流路 1 0 1 にはアフィニティークラムからなる分離部 2 0 6 が設けられており、その下流にはさらに廃液溜 2 0 8 が設けられている。そして、第一の流路 1 0 1 の途中には、制御構造 2 0 4 と分離部 2 0 6 とに挟まれた位置に第三の流路 2 0 3 が設けられており、その先端にはサンプルと洗浄液の導入部 5 0 2 が設けられている。

【0 2 4 1】

また、このアフィニティークロマトグラフィー装置の第二の流路 1 0 2 は、同様に本実施形態のマイクロチップに設けられたグラディエント形成装置のグラディエント流路 4 0 5 と連通している。また、このグラディエント流路 4 0 5 はグラディエント液の流動方向 5 0 6 の方向に向いており、このグラディエント流路 4 0 5 の開始点には溶液導入部 4 0 1 が設けられている。さらに、このグラディエント流路 4 0 5 と略平行に、バッファー流路 4 0 4 が設けられており、グラディエント流路 4 0 5 とバッファー流路 4 0 4 とは、グラディエント液とバッファー液の一部または全部の成分を透過し得る隔壁 4 0 6 を介して隔てられている。この隔壁は、例えば平面限外濾過構造を備えている。

【0 2 4 2】

そして、このバッファー流路 4 0 4 は、グラディエント流路 4 0 5 の流動方向 4 0 5 とは対向する方向であるバッファー流路の流動方向 5 0 4 を向いている。このバッファー流路 4 0 4 の開始点には、バッファー槽 4 0 2 が設けられており、バッファー流路 4 0 4 の先端には廃液溜 4 0 7 が設けられている。このバッファー流路 4 0 4 の下流には、廃液溜 4 0 7 の手前に液体スイッチ 4 1 0 が設けられており、液体スイッチ 4 1 0 のトリガー流路 4 0 8 は、グラディエント流路 4 0 5 の液体導入部 4 0 1 のすぐ下流に連通する。

【0 2 4 3】

この本実施形態のマイクロチップを用いてアフィニティークロマトグラフィーを行うには、まず、サンプルをサンプルと洗浄液の導入部 5 0 2 から導入し、アフィニティークラムからなる分離部 2 0 6 と反応させる。次に、同じサンプルと洗浄液の導入部 5 0 2 からバッファーからなる洗浄液を導入することで、アフィニティークラムからなる分離部 2 0 6 を洗う。この時、洗浄液はグラディエント流路 4 0 5 と連通する第二の流路 1 0 2 に逆流することは無い。逆止弁として機能する制御構造 2 0 4 の第二の流路 1 0 2 の側に液体が存在しないため、洗浄液が制御構造 2 0 4 を超えることができないからである。

【0 2 4 4】

次に、バッファー導入部からバッファー流路 4 0 4 にバッファーを充填する。バッファーは、バッファー流路 4 0 4 を進行したのち液体スイッチ 4 1 0 部分で停止する。導入された残りのバッファーは、バッファー導入部に設けられたリザーバーからなるバッファー槽 4 0 2 にたまる。

【0 2 4 5】

次に、脱離液導入部 4 0 1 から脱離液、例えば、高濃度の塩溶液などを導入する。脱離液は別名脱離液ともいう。この脱離液はグラディエント流路 4 0 5 を進行し、一部はトリガー流路 4 0 8 を進んで、バッファー流路 4 0 4 を開通させる。同時にバッファー流路 4 0 4 内にグラディエント流路 4 0 5 を進行する脱離液と逆向きの流れが生じ、対向流効果でグラディエント流路 4 0 5 内の液体に経時的な塩濃度のグラディエントが形成される。

【0 2 4 6】

既にグラディエントを形成した脱離液は、バッファー導入部に連通するバッファー槽 4 0 2 にたまっていたバッファーが流れ終わって停止すると、ほぼその濃度勾配を保ったま

まグラディエント流路405を制御構造204にまで到達する。制御構造204の反対側の第一の流路101に先に洗浄に用いた別のバッファー液が存在する。そのため、グラディエント液は制御構造204にて停止することなくアフィニティークラムからなる分離部206へと進行する。その結果、アフィニティークラムに吸着された特定物質の分離が実現する。

【0247】

よって、本実施形態のマイクロチップを用いれば、この制御構造204を備える装置にアフィニティークラムからなる分離部206などを設けた場合に、サンプルや洗浄液がグラディエント形成装置の方へ逆流することがない。または、グラディエント形成装置で形成されたグラディエント液からなる脱離液をアフィニティークラムからなる分離部206などに導入することができる。そのため、マイクロチップ単体でアフィニティークロマトグラフィーを実現することが可能となる。

【0248】

すなわち、チップ単体でアフィニティークロマトグラフィーを実現するために重要な、試料とカラムを反応させた後に残りのカラムを洗浄する操作とカラムに結合しているリガンドを脱離液で分離する操作とを行うことができる。さらに、抽出操作はカラムに脱離液の濃度が次第に高くなるように供給することで、カラムへの結合力が弱いものから順に抽出することができる。そのため、チップ単体でのアフィニティークロマトグラフィーによるリガンドの精製が可能になる。

【0249】

このように、本実施形態のマイクロチップは、洗浄操作における逆流抑制に必要な制御構造と、脱離液の濃度勾配を形成するグラディエント形成装置とを備えている。そのため、チップ上で、アフィニティークロマトグラフィーを実現することにより、サンプルや溶媒が少量でよく、グラディエントを作るための外付け装置が不要なマイクロチップであるといえる。よって、本実施形態のマイクロチップは、実用的には、感染症の診断でウイルス抗原を夾雑物から分離する前処理に使って、検査精度を向上させることに利用できる。

(実施形態15)

図16は、本実施形態の質量分析システムの構成を示す概略図である。

【0250】

図16において、試料台上に乾燥試料が設置される。そして、真空下で乾燥試料に波長337nmの窒素ガスレーザーが照射される。すると、乾燥試料はマトリックスとともに蒸発する。試料台は電極となっており、電圧を印加することにより、気化した試料は真空中を飛行し、リフレクター検知器、リフレクター、およびリニア検知器を含む検知部において検出される。

【0251】

図17は、本実施形態の乾燥装置を含む質量分析システムのブロック図である。このシステムは、試料1001について、夾雑物がある程度除去する精製1002、不要成分1004を除去する分離1003、分離した試料の前処理1005、前処理後の試料の乾燥1006、の各ステップを実行する手段を備えている。これらの各手段のうち一部または全部を一または二以上のマイクロチップ1008上に搭載することができる。試料をマイクロチップ1008上で連続的に処理することにより、微量の成分についても損出が少ない方法で効率よく確実に同定を行うことが可能になる。

【0252】

すなわち、本実施形態の質量分析システムは、生体試料を分子サイズまたは性状に応じて分離する分離手段と、この分離手段により分離された試料に対し、酵素消化処理を含む前処理を行う前処理手段と、前処理された試料を乾燥させる乾燥手段と、乾燥後の試料を質量分析する質量分析手段と、を備え、この分離手段は、上記のマイクロチップを含む質量分析システムとすることができる。

【0253】

このような構成とすることにより、試料をマイクロチップ上で連続的に処理することが

できる。その結果、微量の成分についても損出が少ない方法で効率よく確実に同定を行うことが可能になる。

(実施形態 16)

【0254】

図30は、本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いる液体スイッチの構成を示す概略図である。

【0255】

図30に示す液体スイッチも、フォトリソグラフィの技術を応用することにより製造することができる。具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジストや光硬化性樹脂などを塗布し、図30に示すようなパターンを形成することにより、液体スイッチを形成できる。なお、図30中で白い領域は疎水性領域を表し、ハッチング領域は親水性領域を表す。

【0256】

この液体スイッチは、図30に示すように、横に並行に伸びる2本の主流路（第一の流路1201および第二の流路1202からなる）が、横に伸びるトリガー流路1203を挟む形で交叉しており、トリガー流路1203の両側に疎水性領域からなる第一の堰き止め部1205および第二の堰き止め部1206が設けられ、主流路を仕切っている。

【0257】

このような構成によれば、この液体スイッチは、本実施形態の制御構造の機能を併せ持つことになる。すなわち、第一の流路1201に水溶液を導入した場合、トリガー流路1203と、さらに反対側の第二の流路1202にも水溶液があるときだけ、主流路が開通することになる。また、3本の流路が並行して設けられているため、液体スイッチの占める面積が小さくてすむ。そのため、基板上に液体スイッチを設けるさいの設計の自由度が増す利点もある。また、この液体スイッチを備えるマイクロチップの小型化の点でも有利である。

【0258】

この平面構造は、水溶液を処理する場合の構造であるが、本実施形態の液体スイッチは特に水溶液の制御に限られるものではない。すなわち、第一の流路に導入される液体が油性溶媒などからなる場合には、上記の平面構造の親水性領域を親油性領域に置き換え、疎水性領域を疎油性領域に置き換えて用いれば、同様の作用効果を得ることができる。

(実施形態 17)

【0259】

図31は、本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いる遅延装置を示す平面図である。

【0260】

この遅延装置も、フォトリソグラフィの技術を応用することにより製造することができる。具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジストや光硬化性樹脂などを塗布し、図31に示すようなパターンを形成することにより、遅延装置を形成できる。なお、図31中で白い領域は疎水性領域を表し、ハッチング領域は親水性領域を表す。

【0261】

この遅延装置は、それぞれ親水性領域からなる導入路1211、導出路1213、遅延流路1215を備えている。導入路1211から導入された水溶液は、遅延流路1215を通過して導出路1213から導出される。この遅延流路の長さや断面積や形状などを調整することにより、遅延流路を水溶液が通過する時間を調整することができる。この遅延装置を組み合わせることにより、所望のタイミングで、上記の実施形態の制御構造やグラディエント形成装置に水溶液を導入することができる。

【0262】

図32は、本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いる遅延装置を示す平面図である。

【0263】

この遅延装置も、フォトリソグラフィーの技術を応用することにより製造することができる。具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジストや光硬化性樹脂などを塗布し、図32に示すようなパターンを形成することにより、遅延装置を形成できる。なお、図32中で白い領域は疎水性領域を表し、ハッチング領域は親水性領域を表す。

【0264】

この遅延装置は、それぞれ親水性領域からなる導入路1211、導出路1213、遅延室1217を備えている。導入路1211から導入された水溶液は、遅延室1217を通過して導出路1213から導出される。この遅延室の体積や形状などを調整することにより、遅延室を水溶液が通過する時間を調整することができる。この遅延装置を組み合わせることにより、所望のタイミングで、上記の実施形態の制御構造やグラディエント形成装置に水溶液を導入することができる。

【0265】

これらの平面構造は、水溶液を処理する場合の構造であるが、本実施形態の遅延装置は特に水溶液の通過時間の制御に限られるものではない。すなわち、導入路に導入される液体が油性溶媒などからなる場合には、上記の平面構造の親水性領域を親油性領域に置き換え、疎水性領域を疎油性領域に置き換えて用いれば、同様の作用効果を得ることができる。

(実施形態18)

【0266】

図33は、本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いる分注装置を示す平面図である。

【0267】

この分注装置も、フォトリソグラフィーの技術を応用することにより製造することができる。具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジストや光硬化性樹脂などを塗布し、図33に示すようなパターンを形成することにより、分注装置を形成できる。なお、図33中で白い領域は疎水性領域を表し、ハッチング領域は親水性領域を表す。

【0268】

この分注装置は、それぞれ親水性領域からなる主流路1221、分注用流路1223a、1223b、1223c、分注槽1225a、1225b、1225cを備えている。

【0269】

この分注装置において、主流路1221に導入された水溶液は、それぞれ分注用流路1223a、1223b、1223cを通過して対応する分注槽1225a、1225b、1225cに分注される。

【0270】

この分注用流路1223a、1223b、1223cの形状は、細すぎると水溶液の通過速度が低下するが、図33に示すように水溶液の流入側の断面積が広く、水溶液の流出側の断面積が狭い形状にすると、水溶液の通過が円滑に進行する。また、この形状によれば、水溶液の逆流を抑制できる。

【0271】

この分注装置では、水溶液は、まず最初に分注槽1225aに分注される。分注槽1225aが満杯に充填されると、次に水溶液は分注槽1225bに分注される。分注槽1225bが満杯に充填されると、次に水溶液は分注槽1225cに分注される。よって、組成が経時的に変化する水溶液をこの分注装置で分注すると、組成の異なる3種類の水溶液に分注することができる。

【0272】

また、分注槽1225a、1225b、1225cにあらかじめ異なる物質を入れておき、反応槽として用いれば、簡単な構成により、同時に3種類の化学反応を実施すること

が可能になる。

【0273】

図34は、本発明の一実施形態のグラディエント形成装置と遅延装置とを組み合わせた構造を示す平面図である。

【0274】

この構造も、フォトリソグラフィーの技術を応用することにより製造することができる。具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジストや光硬化性樹脂などを塗布し、図34に示すようなパターンを形成することにより、この構造を形成できる。なお、図34中で白い領域は疎水性領域を表し、ハッチング領域は親水性領域を表す。

【0275】

この構造は、バッファー導入口1231、廃液溜1233、塩溶液導入口1235、バッファー流路1237、グラディエント流路1239、複数の連通流路1243を備える隔壁1241、複数の連通流路間に設けられた疎水性領域1245からなるグラディエント形成装置を備える。また、主流路1249、分注用流路1251a, 1251b, 1251c、分注槽1253a, 1253b, 1253c、廃液溜1255からなる分注装置も備える。さらに、グラディエント形成装置と分注装置とを連通する連通流路1247も備える。

【0276】

このような構成により、上記のグラディエント形成装置についての実施形態において説明したように、グラディエント流路1239において塩溶液のグラディエント溶液が形成される。次いで、グラディエント溶液は、グラディエント形成装置のグラディエント流路1239から、連通流路1247を介して、分注装置の主流路1249に導入される。そして、主流路1249に導入されたグラディエント溶液は、分注用流路1251a, 1251b, 1251cを介して、分注槽1253a, 1253b, 1253cに順に分注される。

【0277】

その結果、例えば、分注槽1253aには薄い濃度の塩溶液、分注槽1253bには中程度の濃度の塩溶液、分注槽1253cには濃い濃度の塩溶液が分注されることになる。この場合、分注槽1253a, 1253b, 1253cにそれぞれ同じ物質をあらかじめ入れておいても、塩溶液の濃度に応じてそれぞれ異なる化学反応が進行する。

【0278】

これらの平面構造は、水溶液を処理する場合の構造であるが、本実施形態のグラディエント形成装置と分注装置の組合せからなる構造は特に水溶液の通過時間の制御に限られるものではない。すなわち、上記のバッファー導入口および塩溶液導入口に導入される液体を、油性溶媒などに変更した場合には、上記の平面構造の親水性領域を親油性領域に置き換え、疎水性領域を疎油性領域に置き換えて用いれば、同様の作用効果を得ることができる。

(実施形態19)

【0279】

図35は、本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせるタイミング調整装置を示す平面図である。

【0280】

このタイミング調整装置も、フォトリソグラフィーの技術を応用することにより製造することができる。具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジストや光硬化性樹脂などを塗布し、図35に示すようなパターンを形成することにより、タイミング調整装置を形成できる。なお、図35中で白い領域は疎水性領域を表し、ハッチング領域は親水性領域を表す。

【0281】

このタイミング調整装置は、サンプル導入口1261、流路1263、反応槽1265

、流路1267、タイミング流路1269、トリガー流路1271、流路1273、反応槽1275、流路1277、タイミング流路1279、タイミング流路1281、流路1283、廃液溜1285を備えている。

【0282】

この構成によれば、サンプル導入口1261に導入された水溶液は、流路1263を通過して反応槽1265に流入し、流路1267の先端まで達する。しかし、このとき、疎水性領域を挟んで対向するトリガー流路1271に水溶液が存在しないので、水溶液は疎水性領域で堰き止められる。

【0283】

サンプル導入口1261に水溶液を導入し続けると、反応槽1265はいずれ満杯となり、タイミング流路1269に水溶液が流入する。タイミング流路1269に連通するトリガー流路1271にも水溶液が流入すると、流路1267の先端のメニスカスとトリガー流路1271のメニスカスとが接触して液体スイッチが開通する。その結果、流路1267から流路1273に水溶液が流入する。

【0284】

さらにサンプル導入口1261に水溶液を導入し続けると、水溶液は反応槽1275に流入し、流路1277の先端まで達する。しかし、このとき、疎水性領域を挟んで対向するトリガー流路1281に水溶液が存在しないので、水溶液は疎水性領域で堰き止められる。

【0285】

サンプル導入口1261に水溶液を導入し続けると、反応槽1275はいずれ満杯となり、タイミング流路1279に水溶液が流入する。タイミング流路1279に連通するトリガー流路1281にも水溶液が流入すると、流路1277の先端のメニスカスとトリガー流路1281のメニスカスとが接触して液体スイッチが開通する。その結果、流路1277から流路1283に水溶液が流入する。流路1283に流入した水溶液は廃液溜1285に流入する。

【0286】

このようにして、本実施形態のタイミング調整装置を用いると、反応槽から次の反応槽へ水溶液が移行するタイミングなどを調整することができる。そのため、反応槽内での化学反応の時間を容易に制御することができる利点がある。

【0287】

図36は、本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いるタイミング調整装置を示す平面図である。

【0288】

このタイミング調整装置も、フォトリソグラフィーの技術を応用することにより製造することができる。具体的には、スライドガラスのように親水性の高い基板に、疎水性の高いフォトレジストや光硬化性樹脂などを塗布し、図36に示すようなパターンを形成することにより、タイミング調整装置を形成できる。なお、図36中で白い領域は疎水性領域を表し、ハッチング領域は親水性領域を表す。

【0289】

このタイミング調整装置は、サンプル導入口1291、流路1293、サンプル導入口1295、タイミング流路1297、反応槽1299、流路1301、トリガー流路1303、流路1305、反応槽1307、流路1311、タイミング流路1309、流路1313を備えている。

【0290】

この構成によれば、サンプル導入口1295に導入された水溶液は、流路1297を通過して反応槽1299に流入し、流路1301の先端まで達する。しかし、このとき、疎水性領域を挟んで対向するトリガー流路1303に水溶液が存在しないので、水溶液は疎水性領域で堰き止められる。

【0291】

このとき、サンプル導入口1291に水溶液を導入すると、水溶液はタイミング流路1293を通過してトリガー流路1303に流入する。すると、流路1301の先端のメニスカスとトリガー流路1303のメニスカスとが接触して液体スイッチが開通する。その結果、流路1301から流路1305に水溶液が流入する。

【0292】

さらにサンプル導入口1295に水溶液を導入し続けると、水溶液は反応槽1307に流入し、流路1311の先端まで達する。しかし、このとき、疎水性領域を挟んで対向するトリガー流路1309に水溶液が存在しないので、水溶液は疎水性領域で堰き止められる。

【0293】

このとき、サンプル導入口1291にさらに水溶液を導入すると、水溶液はタイミング流路1293を通過してトリガー流路1309に流入する。すると、流路1311の先端のメニスカスとトリガー流路1309のメニスカスとが接触して液体スイッチが開通する。その結果、流路1311から流路1313に水溶液が流入する。

【0294】

このようにして、本実施形態のタイミング調整装置を用いると、反応槽から次の反応槽へ水溶液が移行するタイミングなどを、サンプル導入口1291に水溶液を導入するタイミングと同期させて調整することができる。そのため、反応槽内での化学反応の時間を容易に制御することができる利点がある。

【0295】

これらの平面構造は、水溶液を処理する場合の構造であるが、本実施形態のタイミング調整装置は特に水溶液の通過時間の制御に限られるものではない。すなわち、上記のサンプル導入口に導入される液体を、油性溶媒などに変更した場合には、上記の平面構造の親水性領域を親油性領域に置き換え、疎水性領域を疎油性領域に置き換えて用いれば、同様の作用効果を得ることができる。

【0296】

以上、本発明の構成について説明したが、これらの構成を任意に組み合わせたものも本発明の態様として有効である。また、本発明の表現を他のカテゴリーに変換したものもまた本発明の態様として有効である。

【図面の簡単な説明】

【0297】

【図1】 本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す平面図である。

【図2】 本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す平面図である。

【図3】 本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す平面図である。

【図4】 本発明の一実施形態の制御構造の構成を別の角度から示す図である。

【図5】 本発明の一実施形態の制御構造の構成の斜視図である。

【図6】 本発明の一実施形態の制御構造に備わる柱状体の表面の構成を示す図である。

。

【図7】 本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す部分断面図である。

【図8】 本発明の一実施形態の制御構造の製造途中の断面図である。

【図9】 本発明の一実施形態の制御構造を備える分離装置を示す図である。

【図10】 通常のカラムによるクロマトグラフィーのためにグラディエント形成を行う従来のグラディエント形成装置の一例を示す概略図である。

【図11】 本発明の一実施形態のグラディエント形成装置を示す概略図である。

【図12】 本発明の一実施形態のグラディエント形成装置の隔壁の構成を示す拡大平面図である。

【図13】 本発明の一実施形態のグラディエント形成装置の隔壁の構成を示す斜視図である。

【図14】 本発明の一実施形態のグラディエント形成装置によるグラディエント形成の様子を示す概念図である。

- 【図 1 5】本発明の一実施形態のマイクロチップを示す概略図である。
- 【図 1 6】本発明の一実施形態の質量分析システムの構成を示す概略図である。
- 【図 1 7】本発明の一実施形態の乾燥装置を含む質量分析システムのブロック図である。
- 【図 1 8】本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す部分断面図である。
- 【図 1 9】本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す部分平面図である。
- 【図 2 0】本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す部分概略図である。
- 【図 2 1】本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す部分断面図である。
- 【図 2 2】本発明の一実施形態のグラディエント形成装置の断面図である。
- 【図 2 3】本発明の一実施形態のグラディエント形成装置の平面図である。
- 【図 2 4】本発明の一実施形態のグラディエント形成装置の隔壁の構成を示す概略図である。
- 【図 2 5】本発明の一実施形態のグラディエント形成装置の隔壁の構成を示す概略図である。
- 【図 2 6】本発明の一実施形態のグラディエント形成装置の順流路および逆流路の構成を示す図である。
- 【図 2 7】本発明の一実施形態のグラディエント形成装置の順流路および逆流路の構成を示す図である。
- 【図 2 8】本発明の一実施形態の制御構造の構成を示す平面図である。
- 【図 2 9】本発明の一実施形態のグラディエント形成装置の隔壁の構成を示す概略図である。
- 【図 3 0】本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いる液体スイッチの構成を示す平面図である。
- 【図 3 1】本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いる遅延装置を示す平面図である。
- 【図 3 2】本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いる遅延装置を示す平面図である。
- 【図 3 3】本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いる分注装置を示す平面図である。
- 【図 3 4】本発明の一実施形態のグラディエント形成装置と遅延装置とを組み合わせた構造を示す平面図である。
- 【図 3 5】本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いるタイミング調整装置を示す平面図である。
- 【図 3 6】本発明の一実施形態の制御構造またはグラディエント形成装置と組み合わせて用いるタイミング調整装置を示す平面図である。

【符号の説明】

【0 2 9 8】

1 0 0	堰き止め部を含む領域
1 0 1	第一の流路
1 0 2	第二の流路
1 0 4	堰き止め部
1 0 6 a	第一の開口部
1 0 6 b	第二の開口部
1 6 1 a	逆流路
1 6 1 b	順流路
1 5 1	特定物質
1 6 5	土手部（隔壁）
1 6 6	基板
1 6 7	流路の壁
1 8 0	被覆

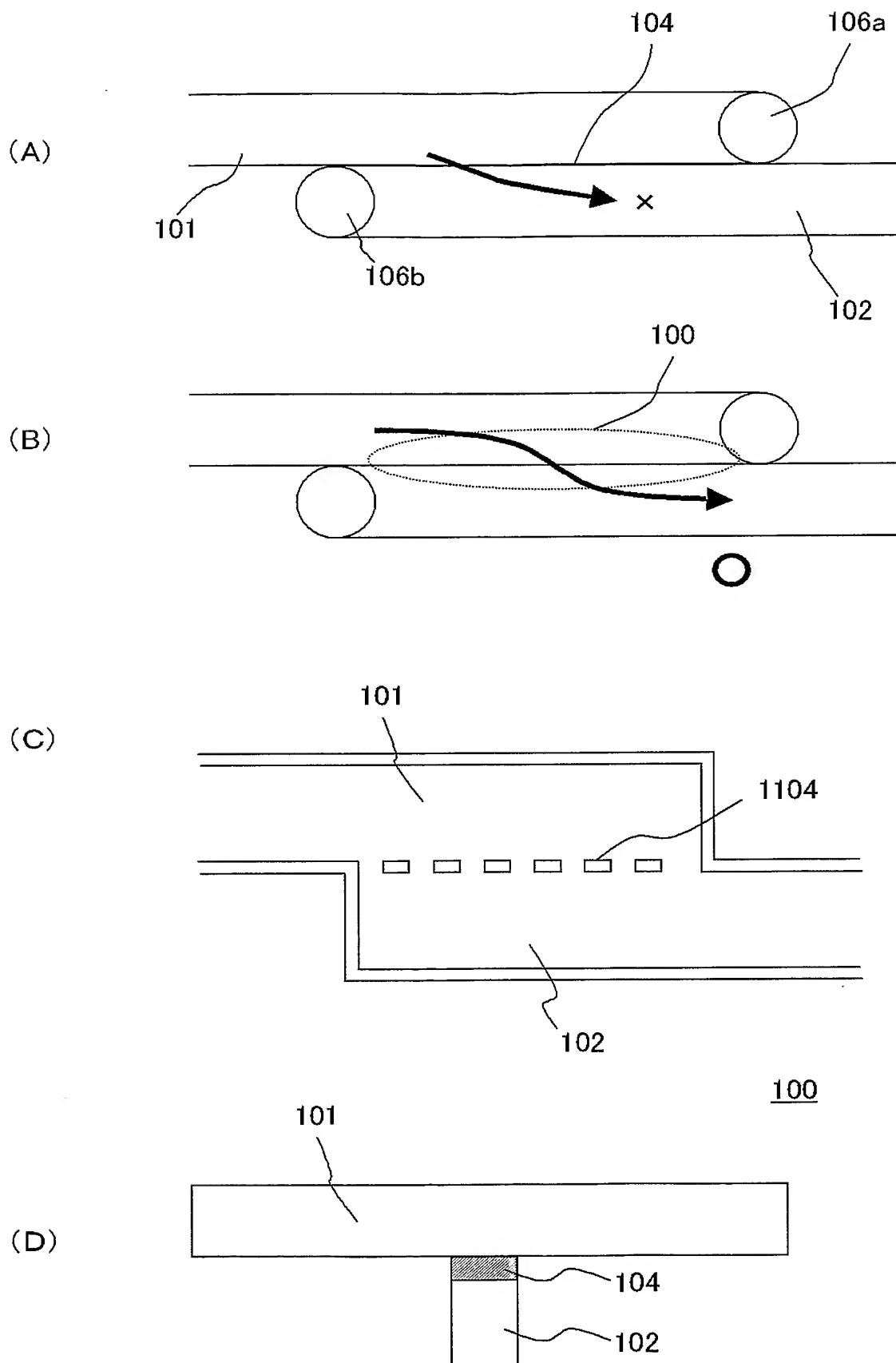
2 0 1	サンプル
2 0 2	洗浄液
2 0 3	第三の流路
2 0 4	制御構造
2 0 6	アフィニティーカラム（分離部）
2 1 0	脱離液
3 0 2 A	A 溶液
3 0 2 B	B 溶液
3 0 4 A	第一の容器
3 0 4 B	第二の容器
3 0 6 A	A 溶液の流路
3 0 6 B	B 溶液の流路
3 0 8 A	A 溶液の可変ポンプ
4 0 1	溶液導入部
4 0 2	バッファー槽
4 0 3	液体スイッチ
4 0 4	バッファー流路
4 0 5	グラディエント流路
4 0 6	隔壁
4 0 7	廃液溜
4 0 8	トリガー流路
4 0 9	堰き止め部
4 1 0	液体スイッチ
4 1 2	空気穴
5 0 2	サンプルと洗浄液の導入部
5 0 4	バッファーの流動方向
5 0 6	グラディエント液の流動方向
8 0 1	第一の流路
8 0 2	第二の流路
8 0 3	トリガー流路
8 0 4	堰き止め部
8 0 5	第一の堰き止め部
8 0 6	第二の堰き止め部
9 0 1	隔壁
9 0 3	順流路
9 0 5	逆流路
9 0 7 a	第一のリザーバ部
9 0 7 b	第二のリザーバ部
9 0 9 a	第一の廃液溜
9 0 9 b	第二の廃液溜
9 1 1	疎水性領域
1 0 0 1	試料
1 0 0 2	精製
1 0 0 3	分離
1 0 0 4	不要成分
1 0 0 5	前処理
1 0 0 6	乾燥
1 0 0 7	質量分析による同定
1 0 0 8	マイクロチップ
1 1 0 4	複数の連通流路を備える隔壁

1 1 6 5	土手部（隔壁）
1 1 6 5 d	隔壁
1 1 6 6	基板
1 1 8 0	被覆（ふた）
1 1 8 0 a	コート層
1 2 0 1	第一の流路
1 2 0 2	第二の流路
1 2 0 3	トリガー流路
1 2 0 5	第一の堰き止め部
1 2 0 6	第二の堰き止め部
1 2 1 1	導入路
1 2 1 3	導出路
1 2 1 5	遅延流路
1 2 1 7	遅延室
1 2 2 1	主流路
1 2 2 3 a	分注用流路
1 2 2 3 b	分注用流路
1 2 2 3 c	分注用流路
1 2 2 5 a	分注槽
1 2 2 5 b	分注槽
1 2 2 5 c	分注槽
1 2 3 1	バッファ導入口
1 2 3 3	廃液溜
1 2 3 5	塩溶液導入口
1 2 3 7	バッファ流路
1 2 3 9	グラデIENT流路
1 2 4 1	隔壁
1 2 4 3	連通流路
1 2 4 5	疎水性領域
1 2 4 7	連通流路
1 2 4 9	主流路
1 2 5 1 a	分注用流路
1 2 5 1 b	分注用流路
1 2 5 1 c	分注用流路
1 2 5 3 a	分注槽
1 2 5 3 b	分注槽
1 2 5 3 c	分注槽
1 2 5 5	廃液溜
1 2 6 1	サンプル導入口
1 2 6 3	流路
1 2 6 5	反応槽
1 2 6 7	流路
1 2 6 9	タイミング流路
1 2 7 1	トリガー流路
1 2 7 3	流路
1 2 7 5	反応槽
1 2 7 7	流路
1 2 7 9	タイミング流路
1 2 8 1	トリガー流路
1 2 8 3	流路

1 2 8 5	廃液溜
1 2 9 1	サンプル導入口
1 2 9 3	タイミング流路
1 2 9 5	サンプル導入口
1 2 9 7	流路
1 2 9 9	反応槽
1 3 0 1	流路
1 3 0 3	トリガー流路
1 3 0 5	流路
1 3 0 7	反応槽
1 3 0 9	トリガー流路
1 3 1 1	流路
1 3 1 3	流路
4 1 0 1	流路を構成する外壁
4 1 0 5	柱状体
4 1 0 7	多数の柱状体を含む領域
4 1 0 9	疎液層
8 2 0 1	支持体
8 2 0 2	底部材料
8 2 0 3	柱状体材料
8 2 0 5	側壁材料
L	隔壁の長さ
W	流路の幅
D	流路の深さ
d 1	複数の流路の幅
d 2	隔壁の幅

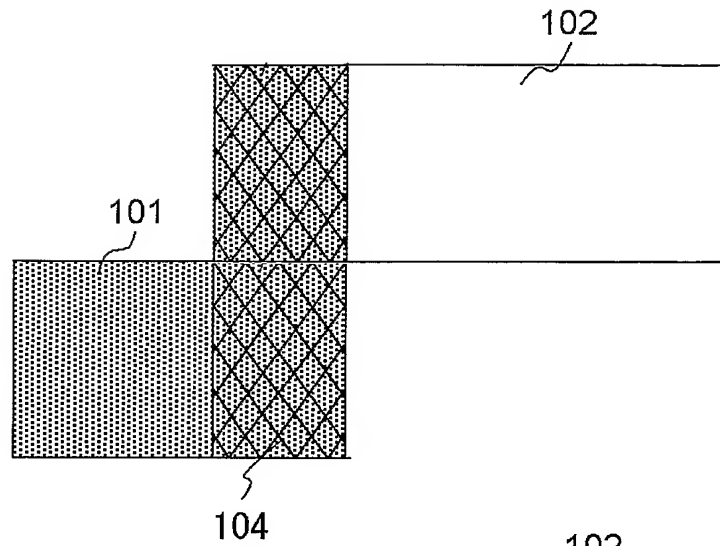
【書類名】 図面

【図 1】

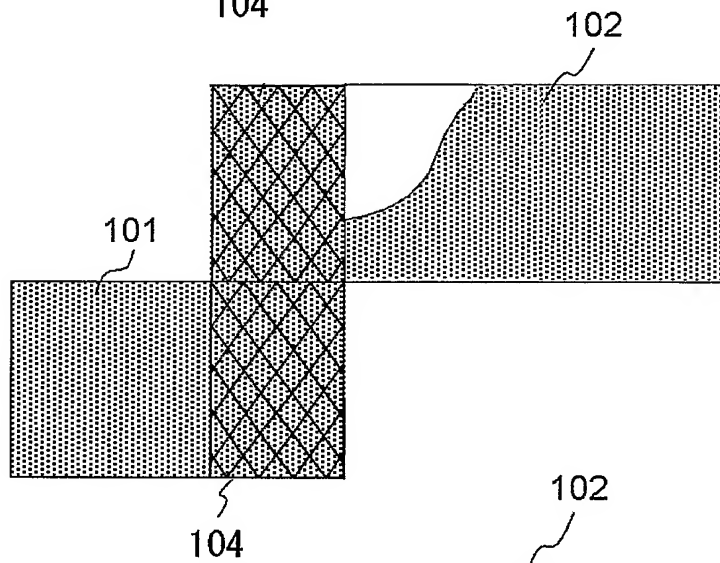


【図 2】

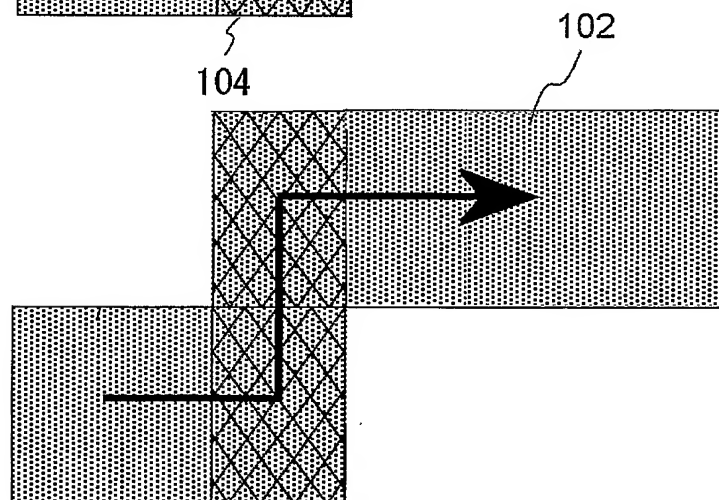
(a)



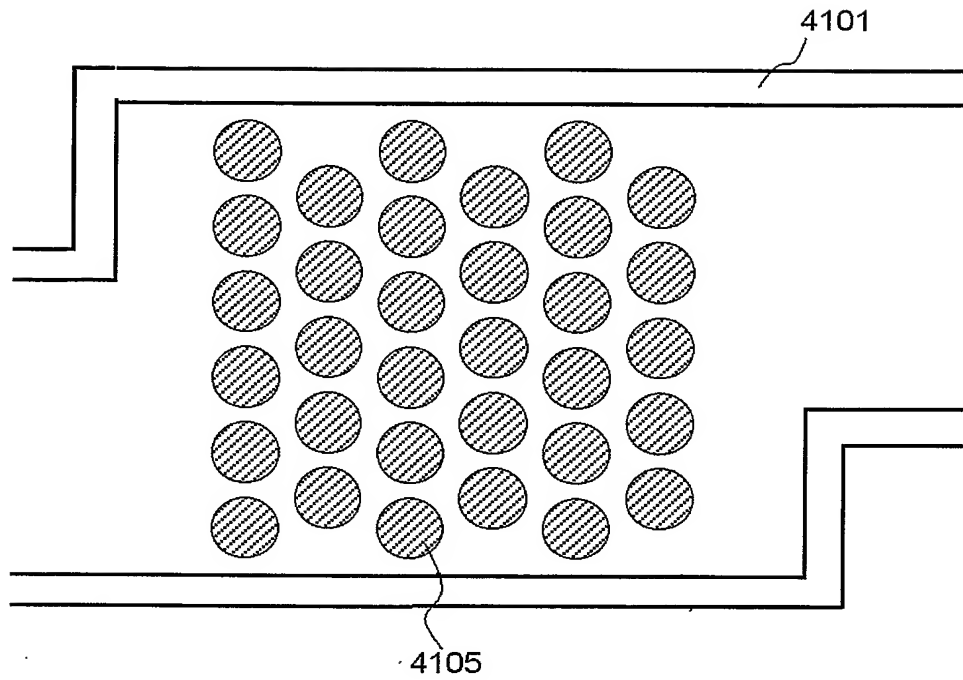
(b)



(c)

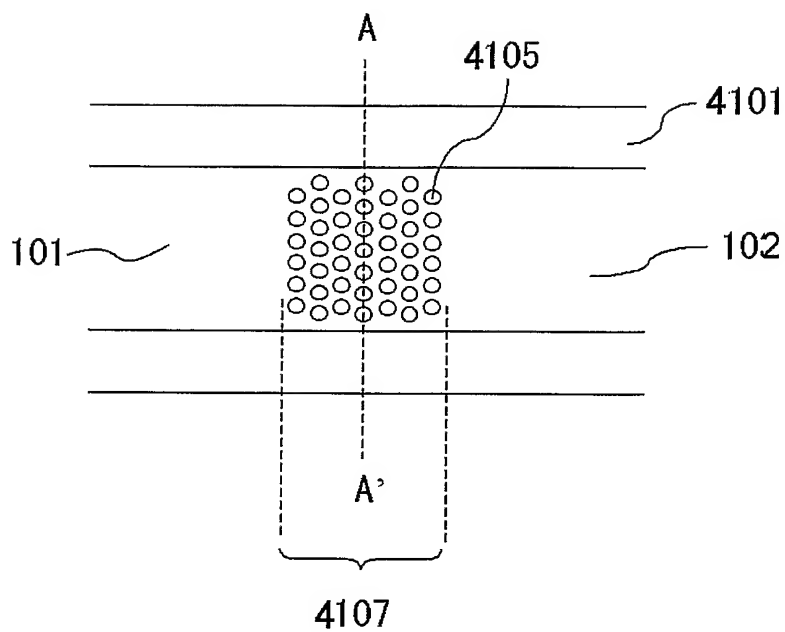


【図 3】

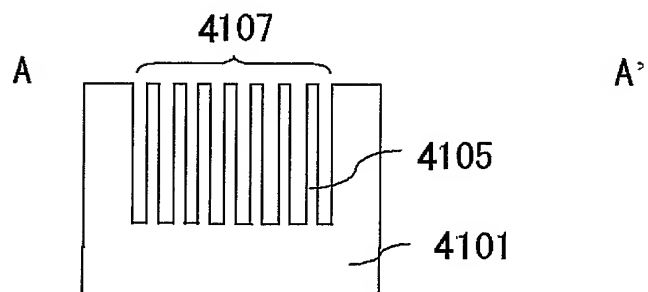


【図 4】

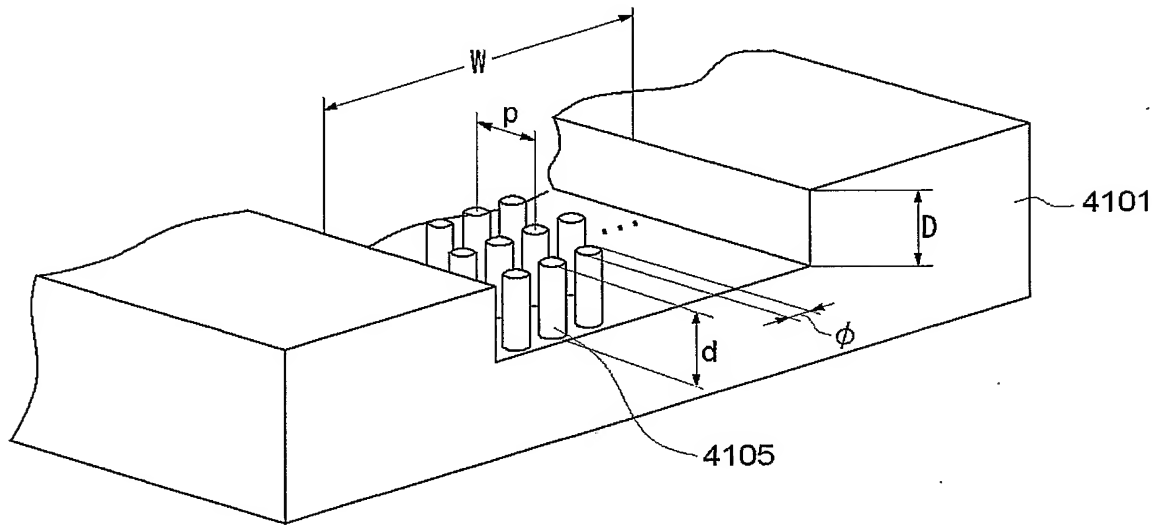
(a)



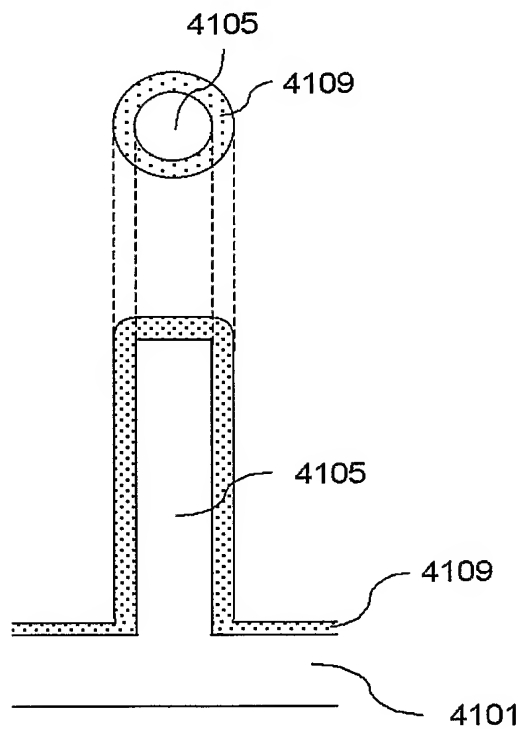
(b)



【図 5】



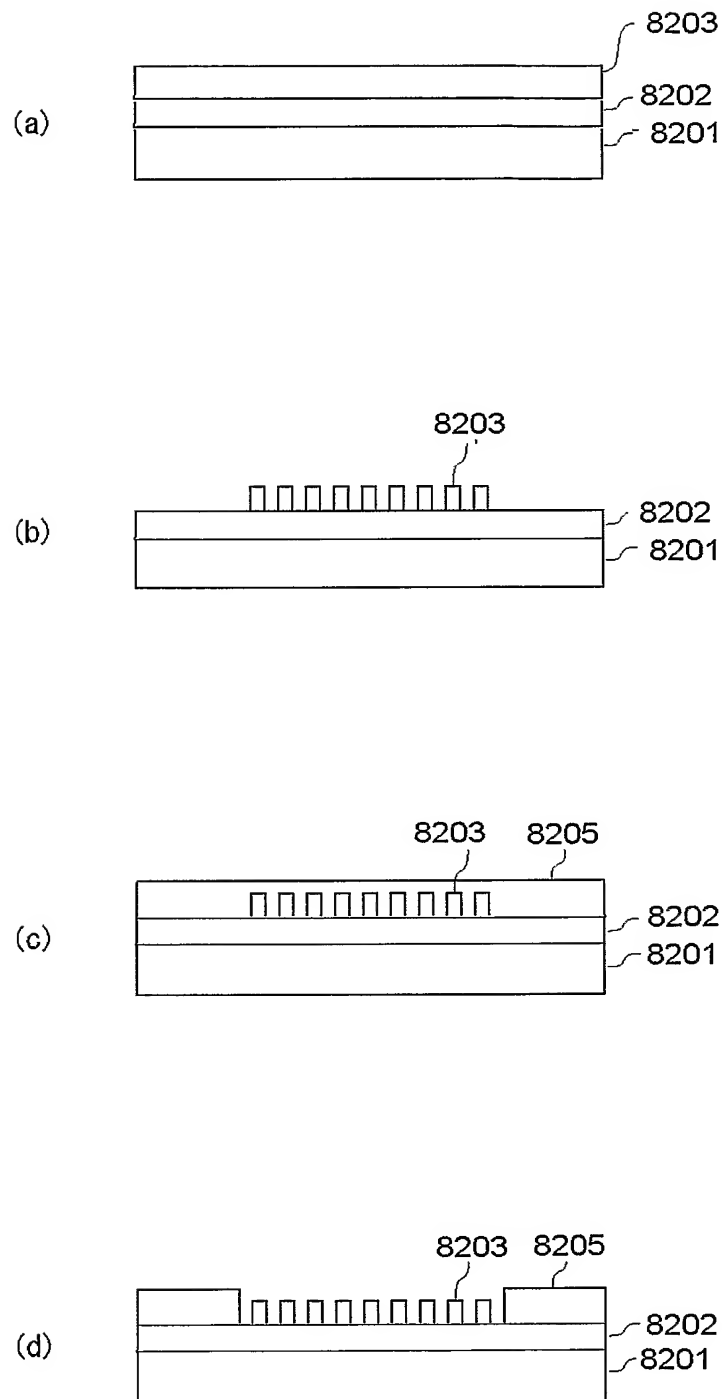
【図 6】



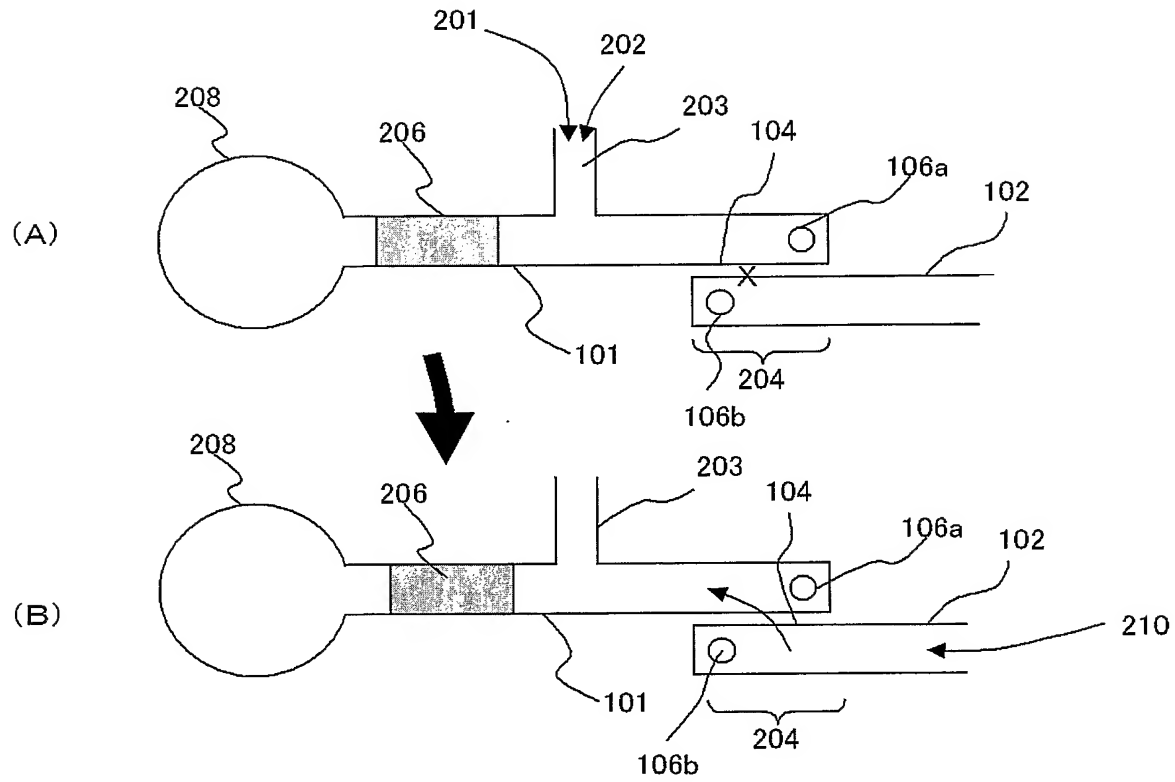
【図 7】



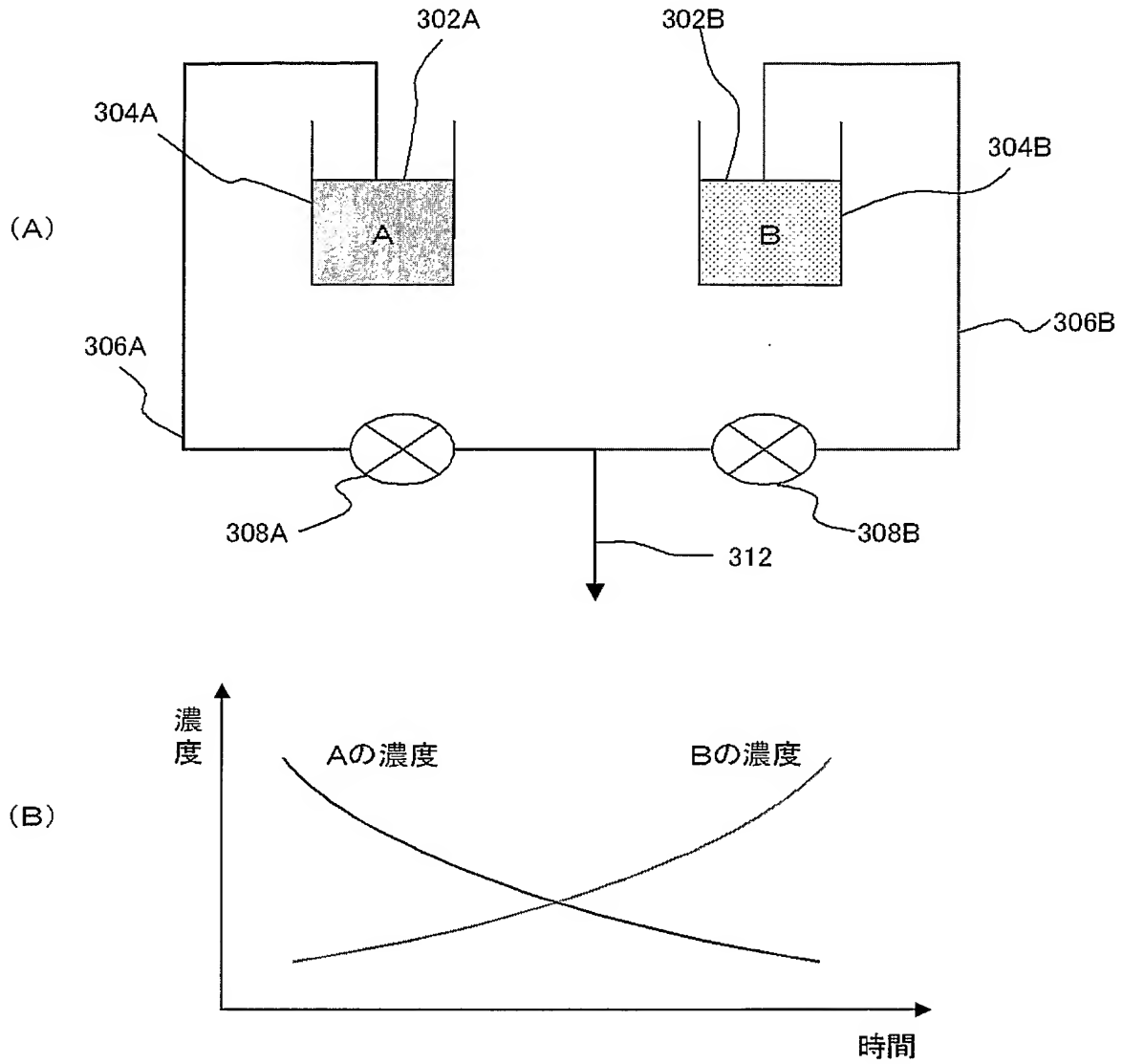
【図 8】



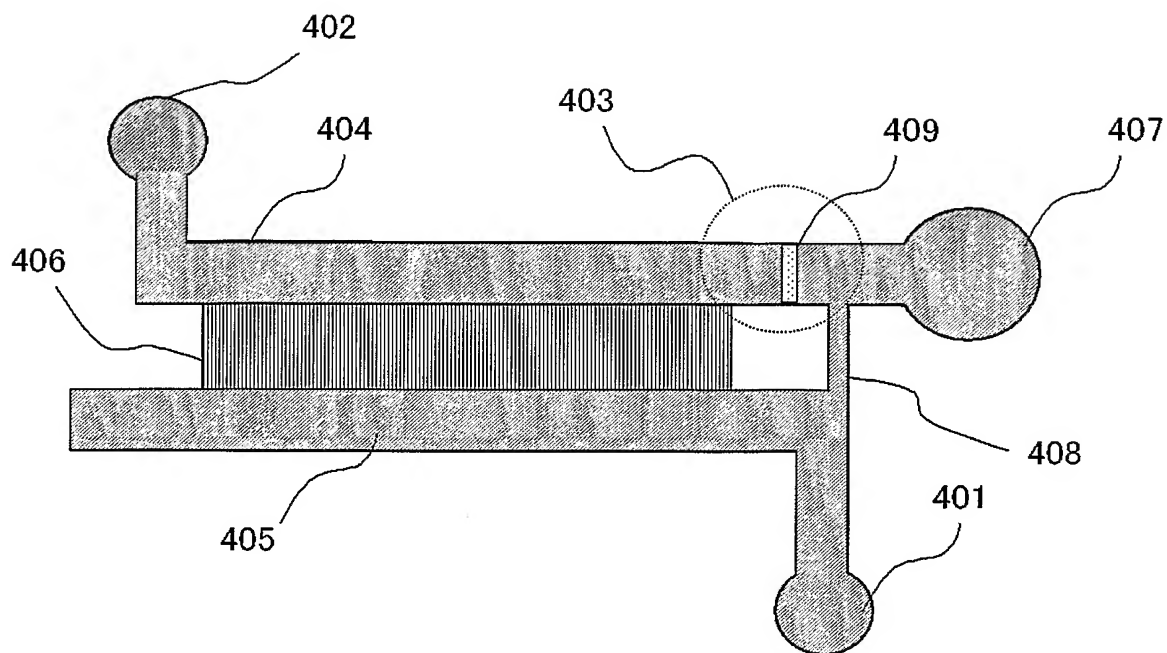
【図 9】



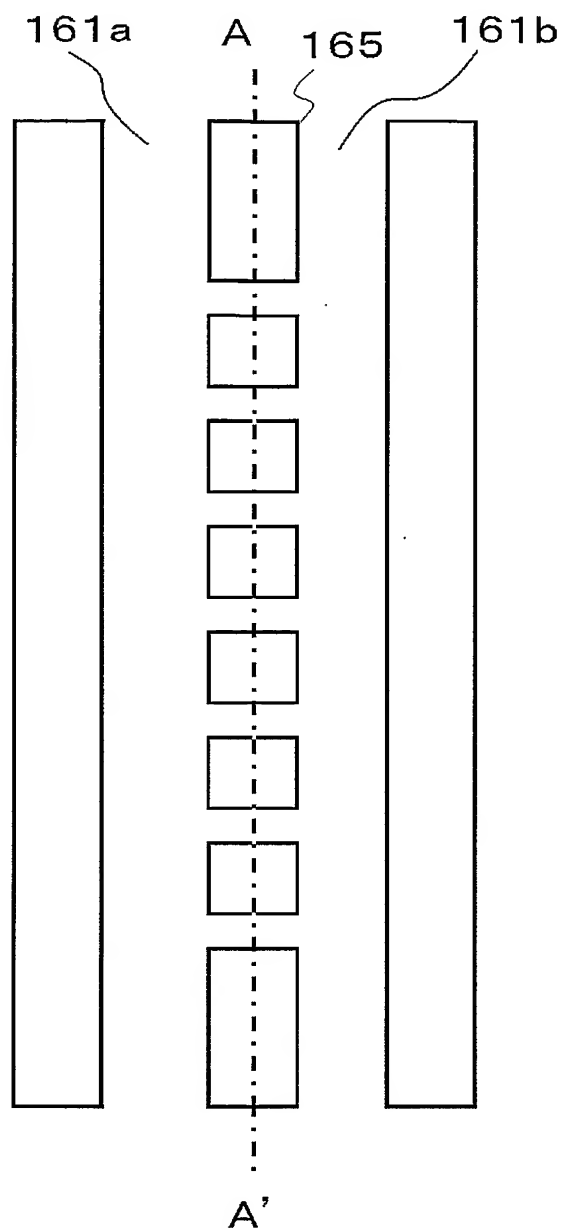
【図 10】



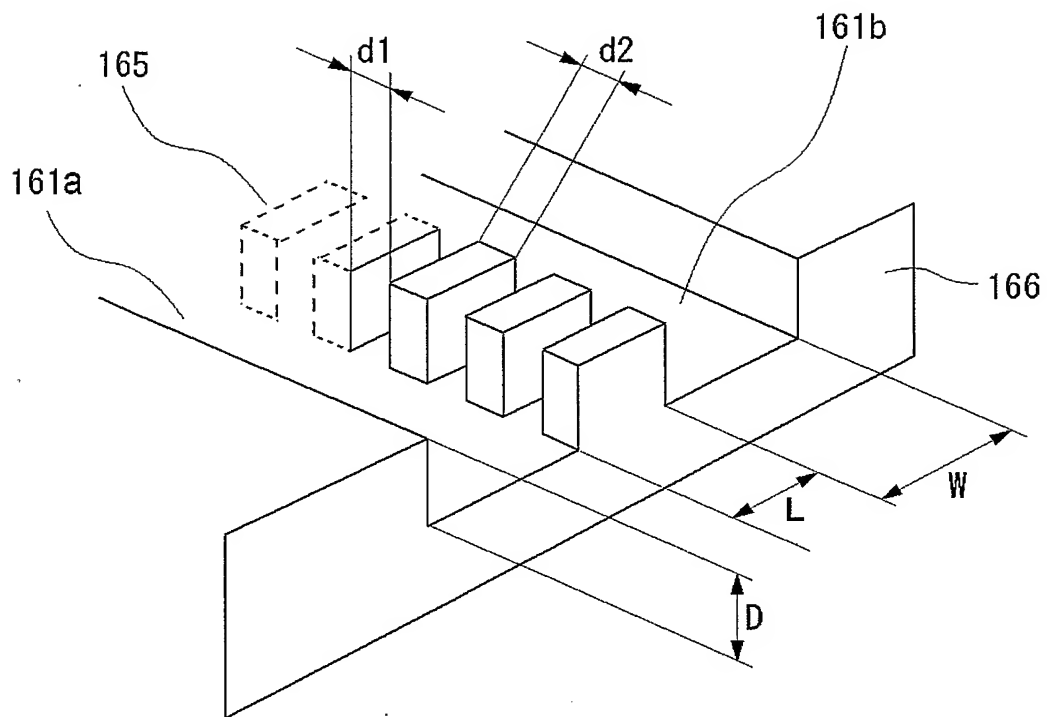
【図 11】



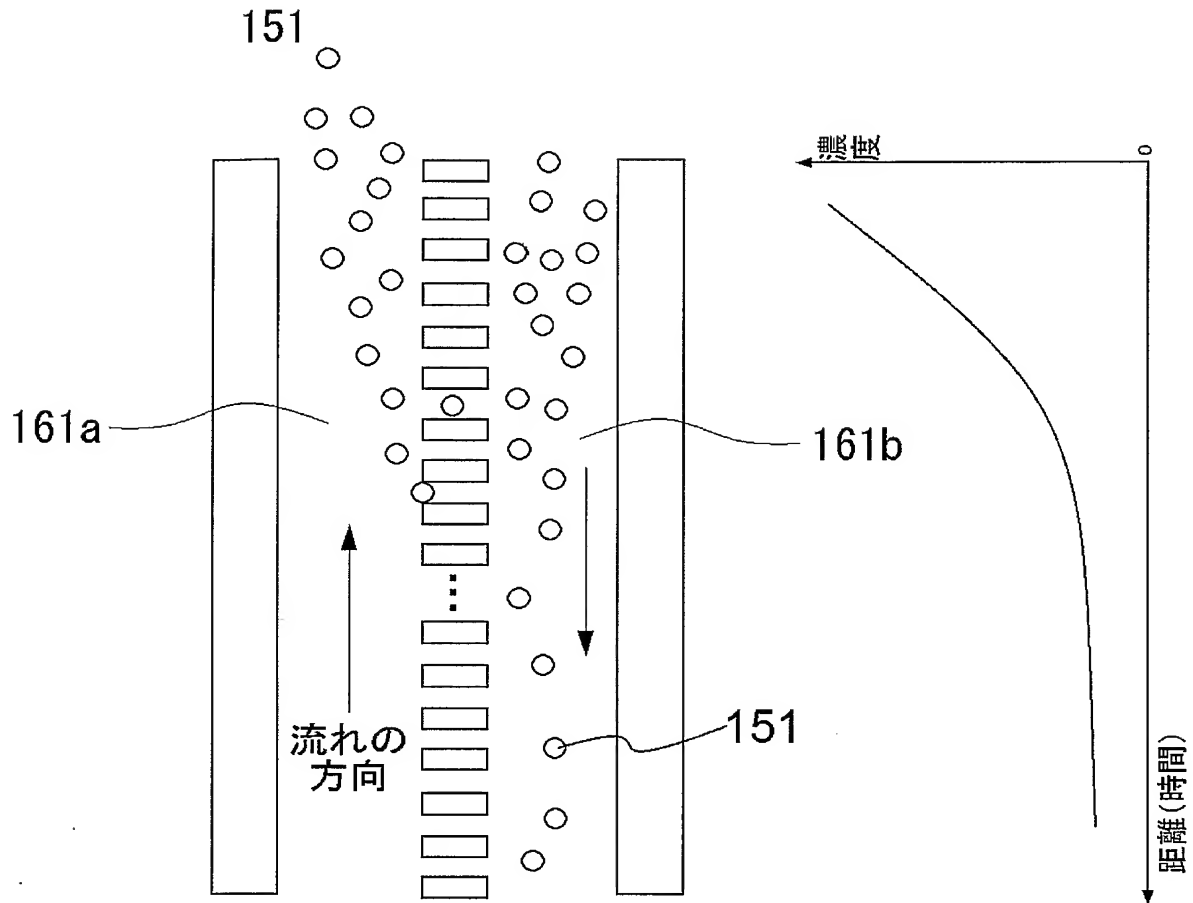
【図 12】



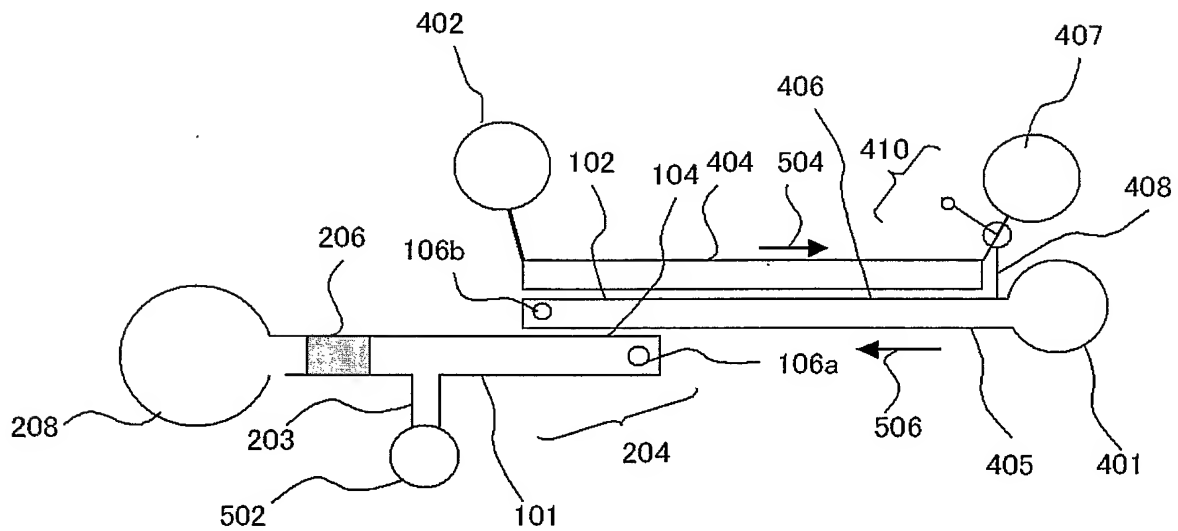
【図 13】



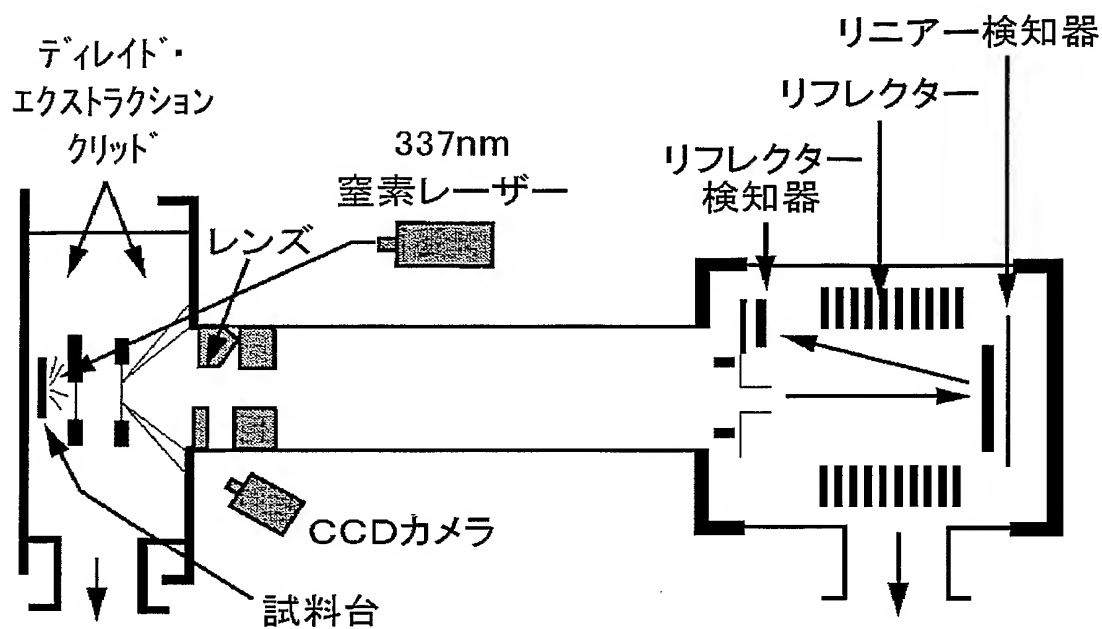
【図 14】



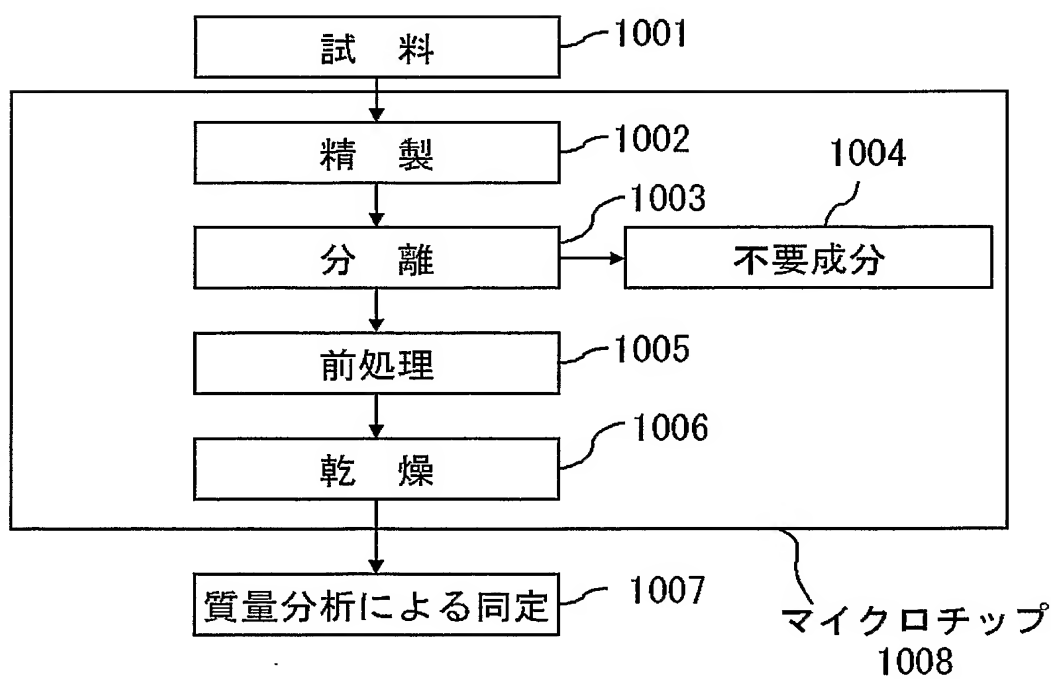
【図 15】



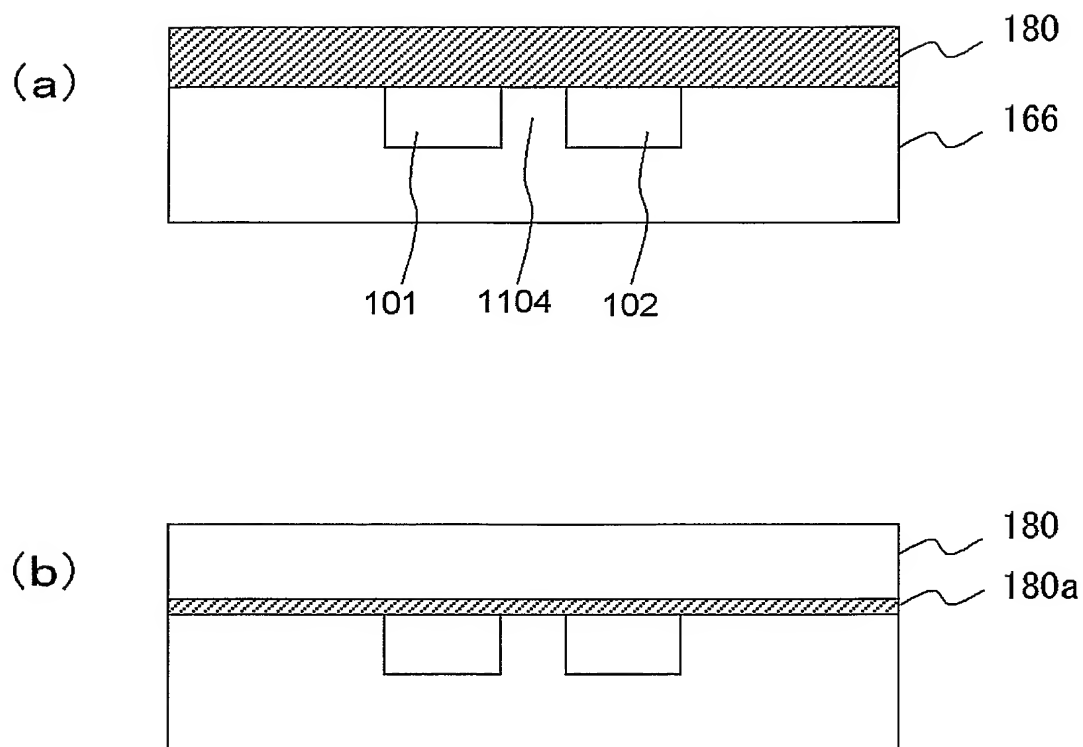
【図 16】



【図 17】

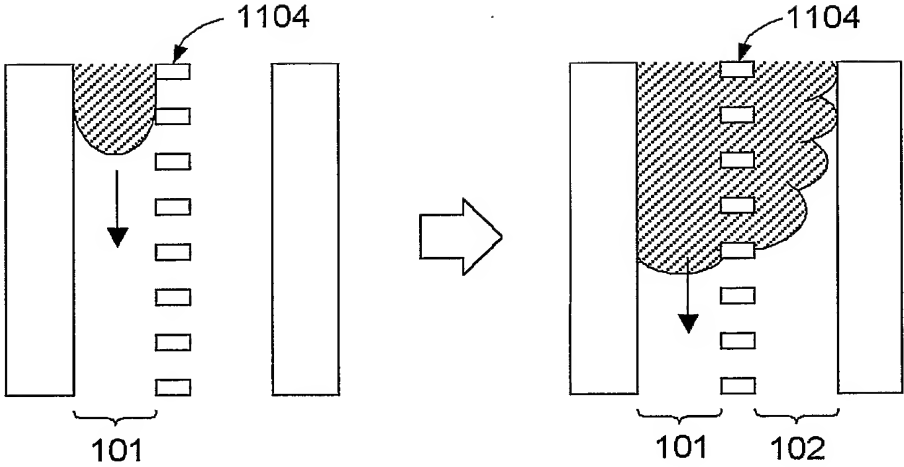


【図 18】

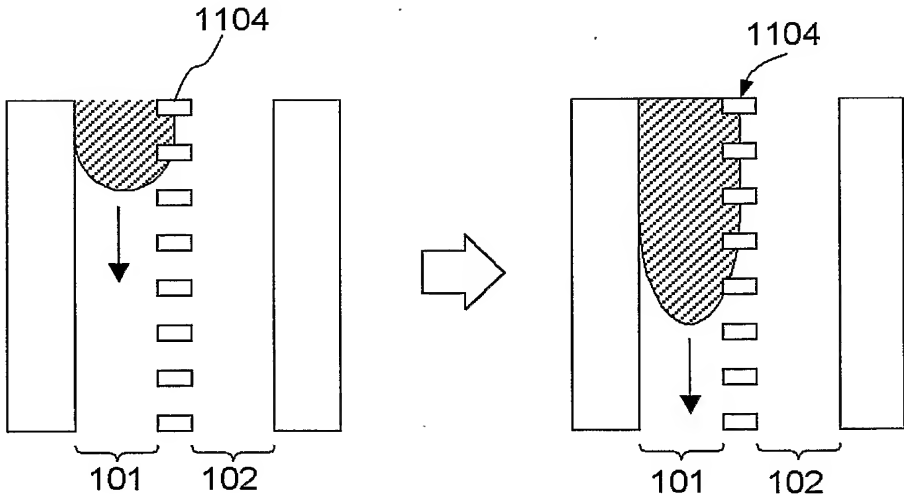


【図 19】

(a)

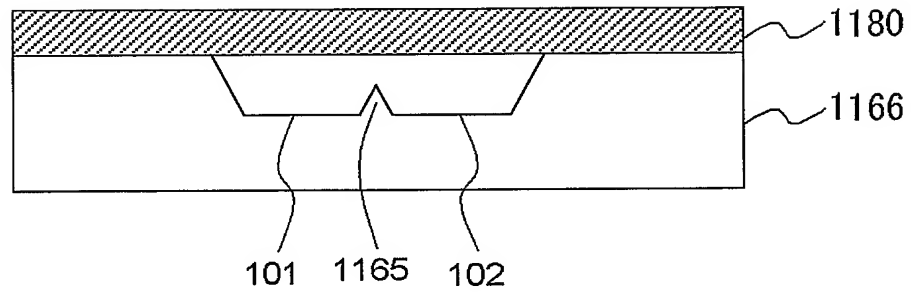


(b)

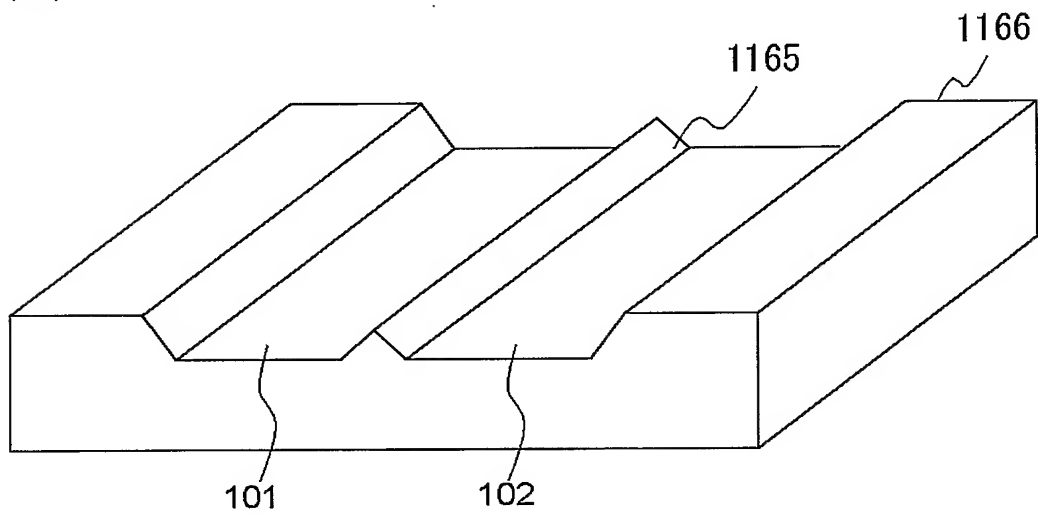


【図 20】

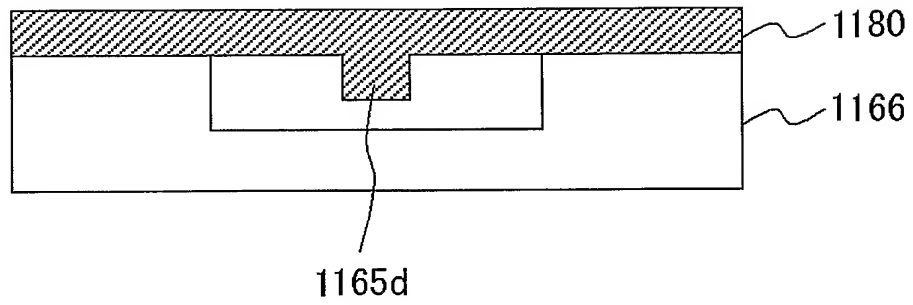
(a)



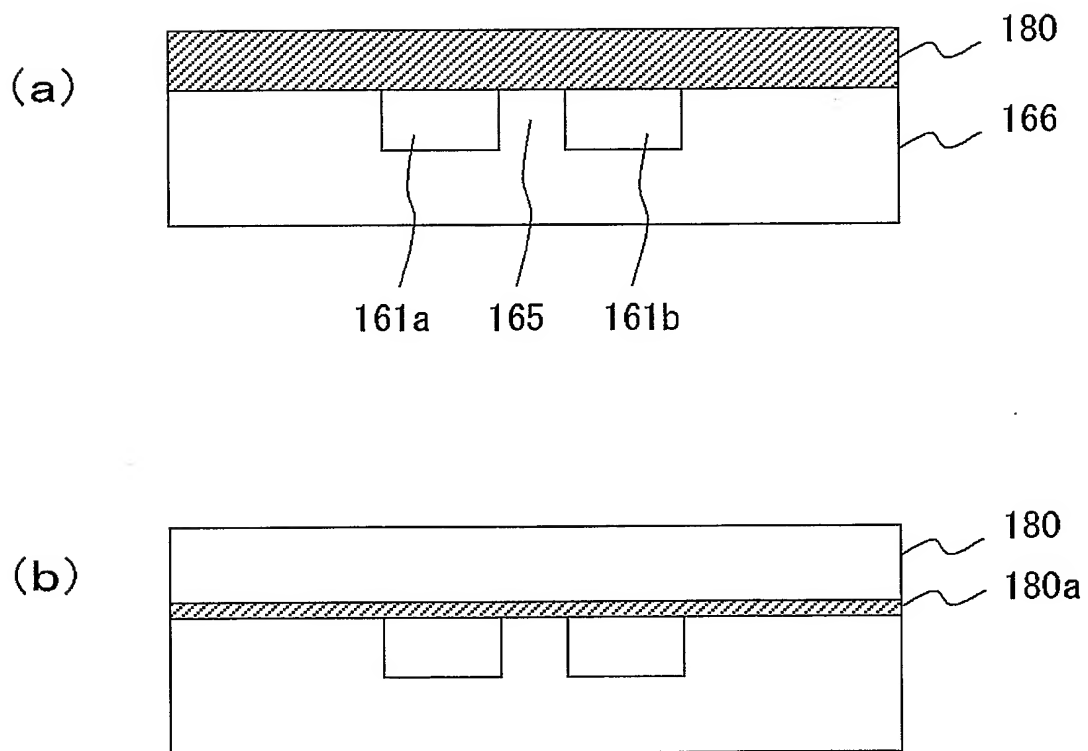
(b)



【図 2 1】

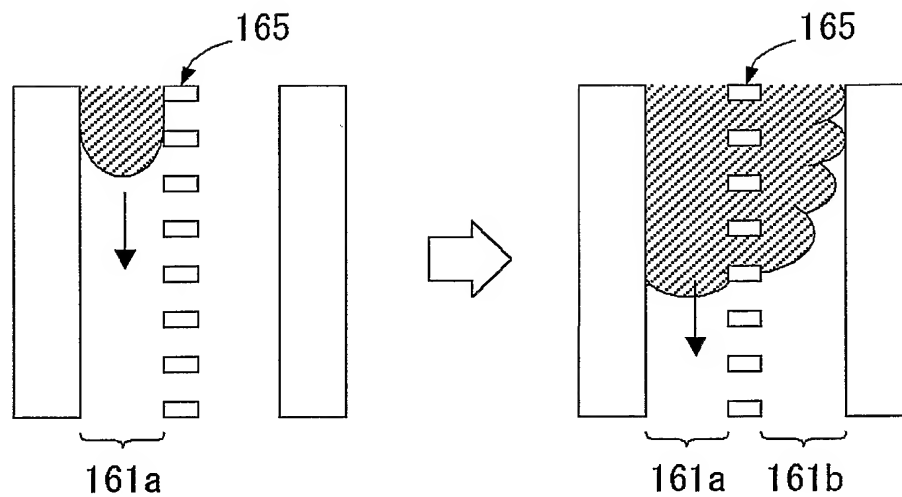


【図 2 2】

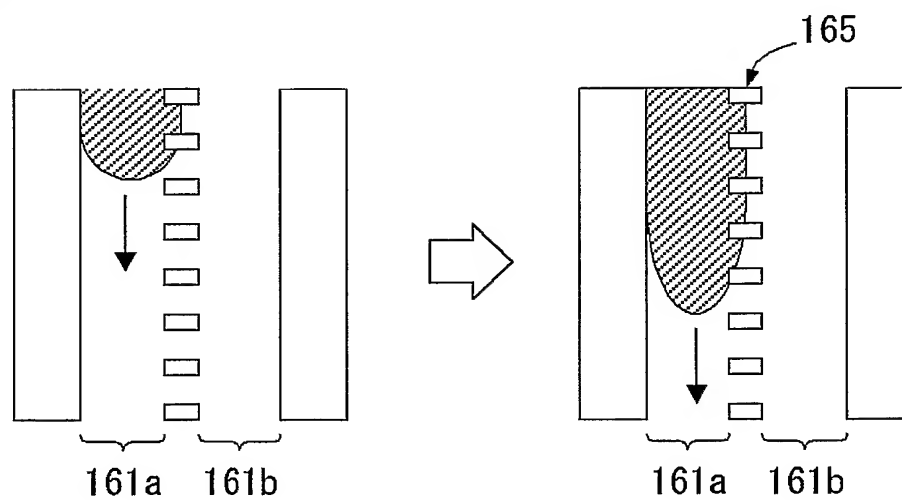


【図 23】

(a)

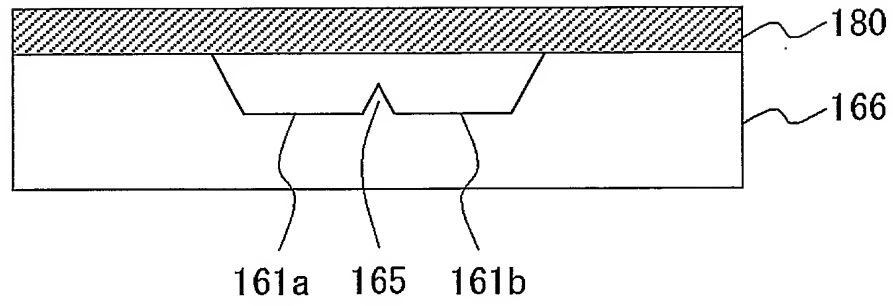


(b)

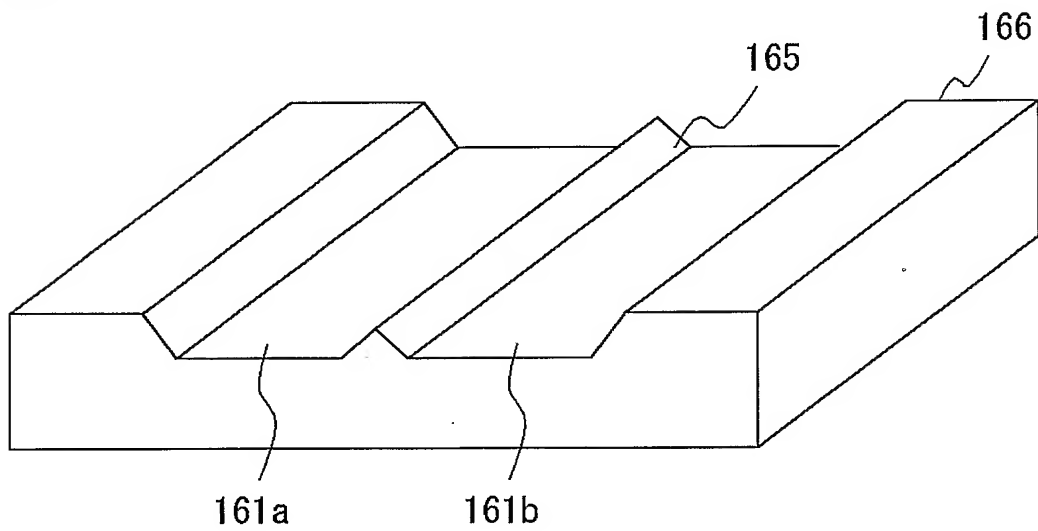


【図 24】

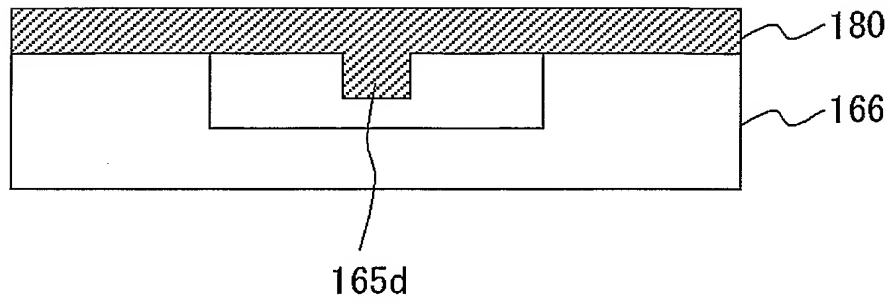
(a)



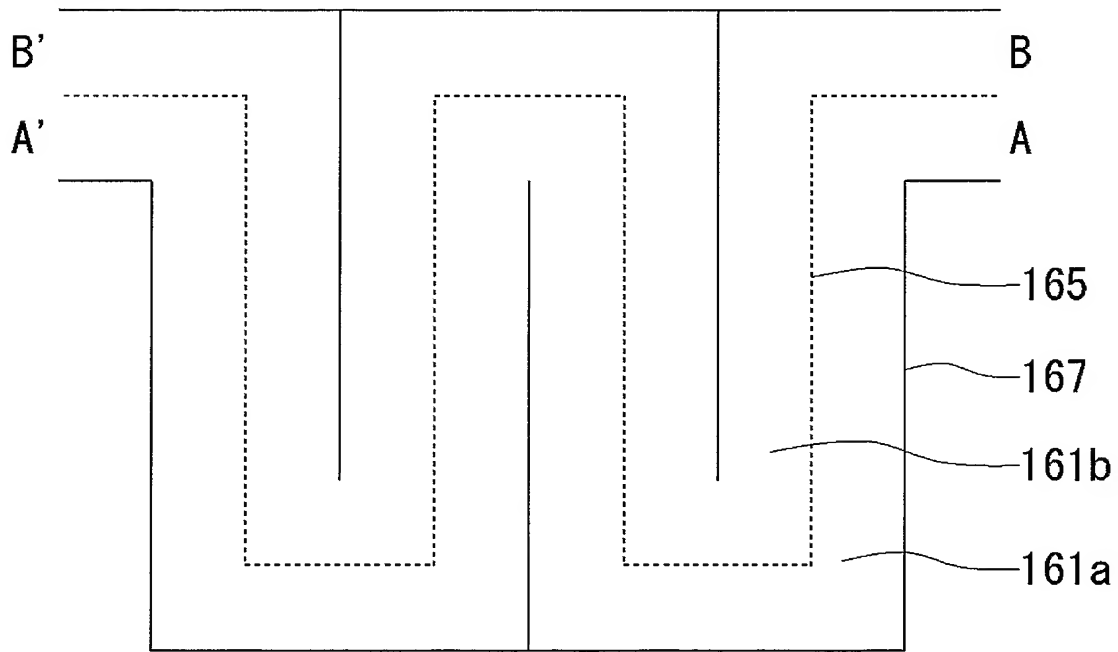
(b)



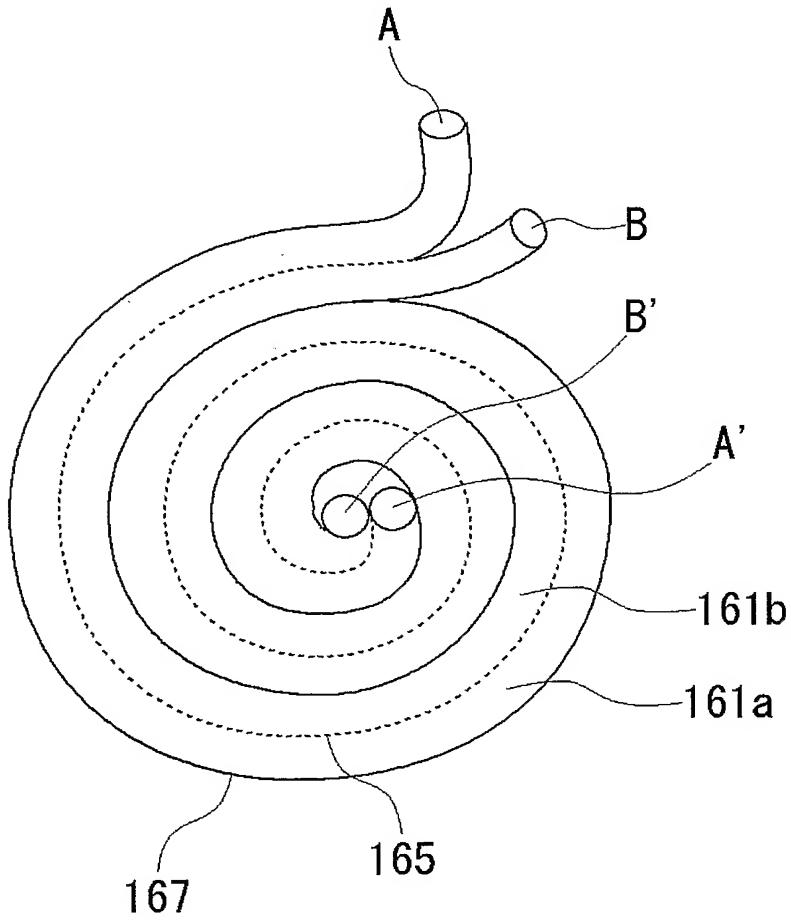
【図 25】



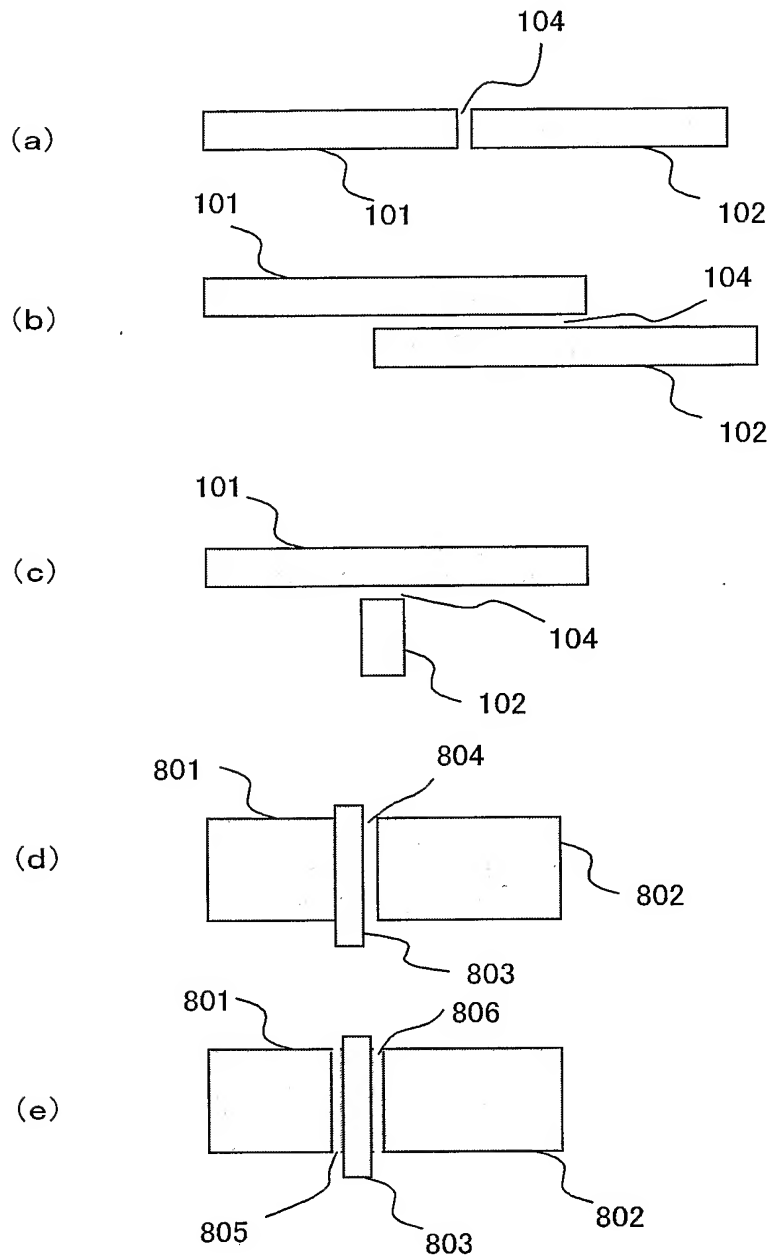
【図 26】



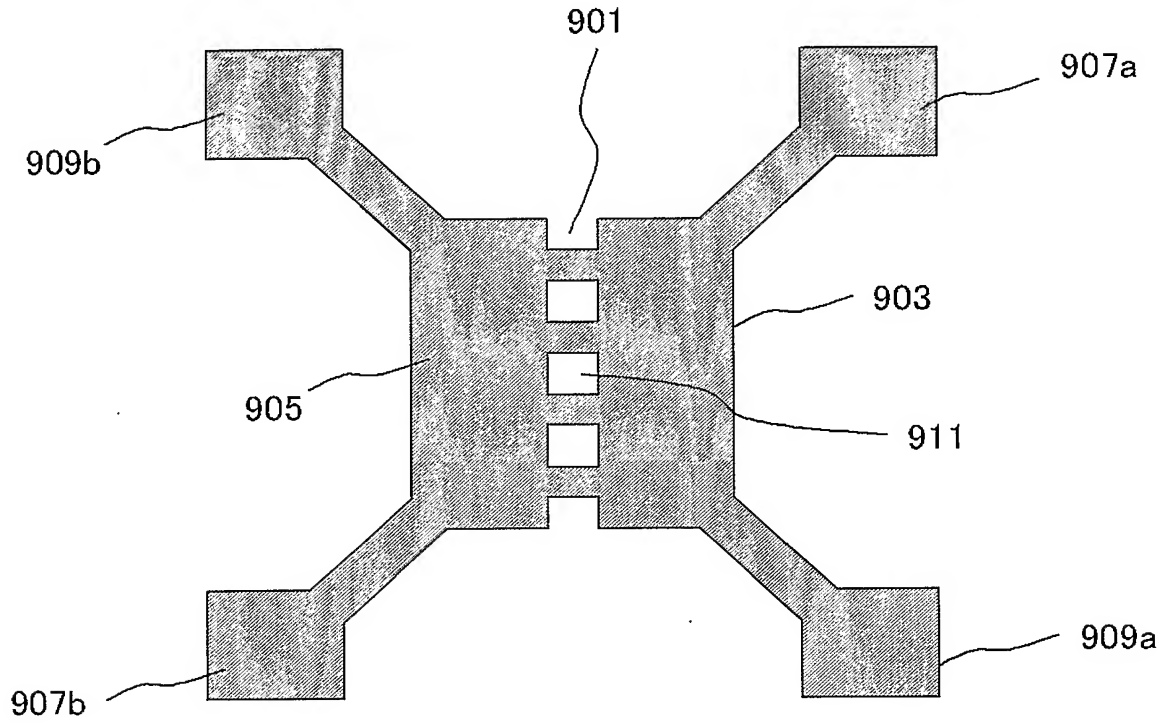
【図 27】



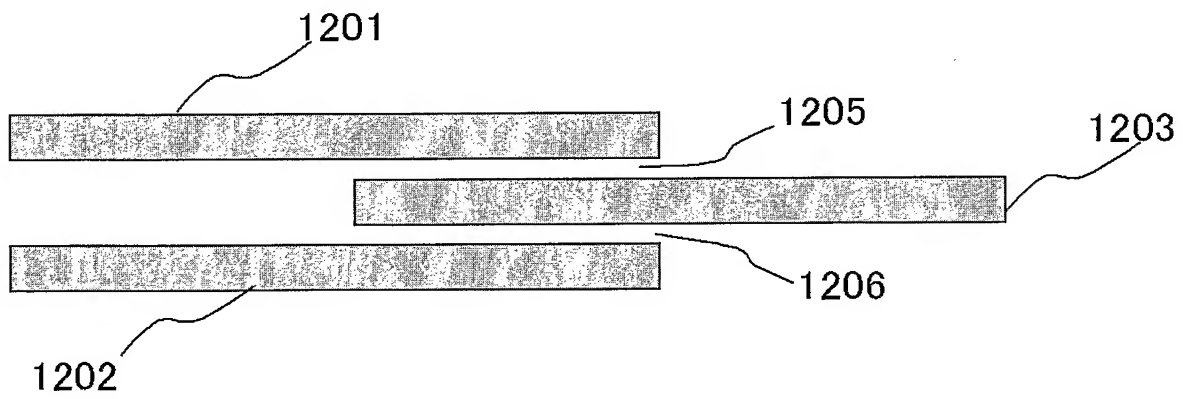
【図 28】



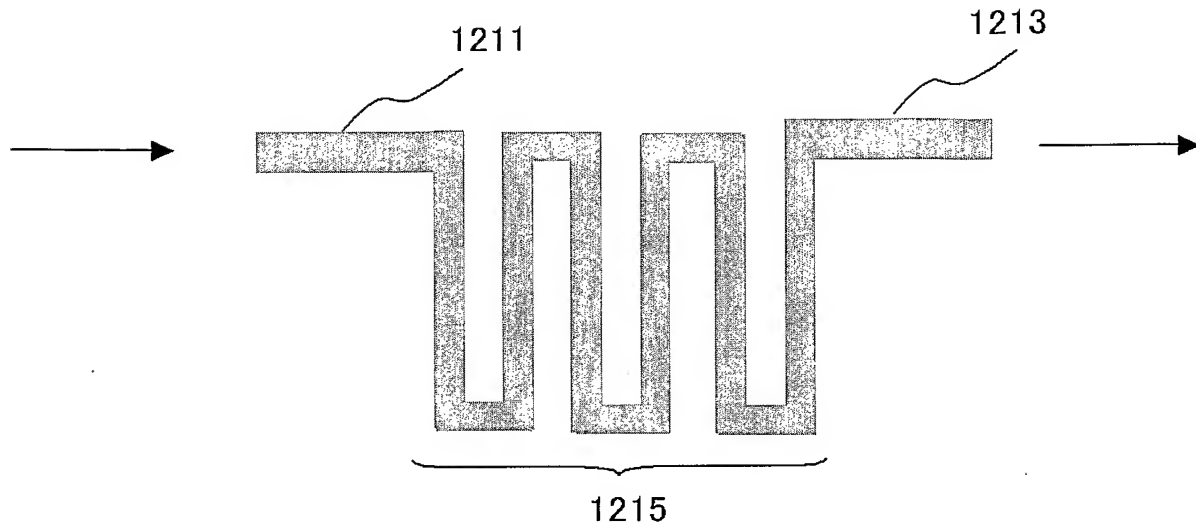
【図 29】



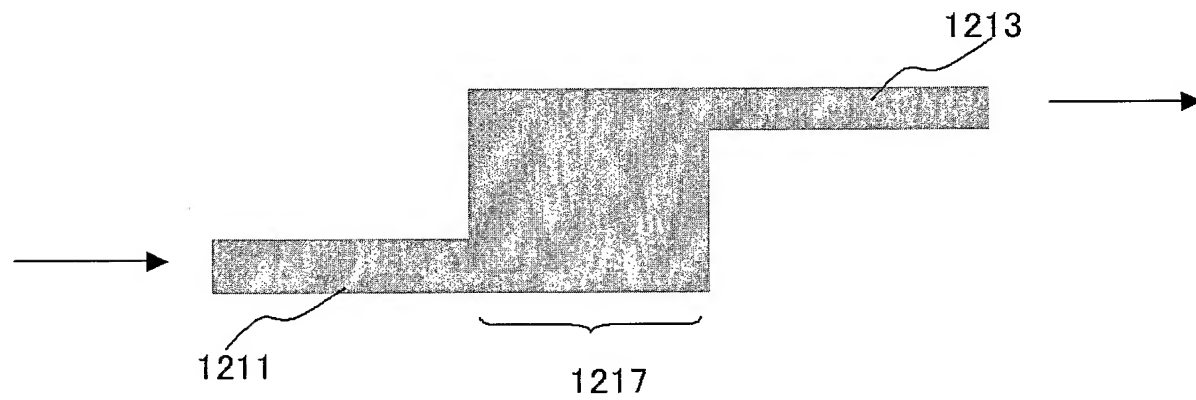
【図 30】



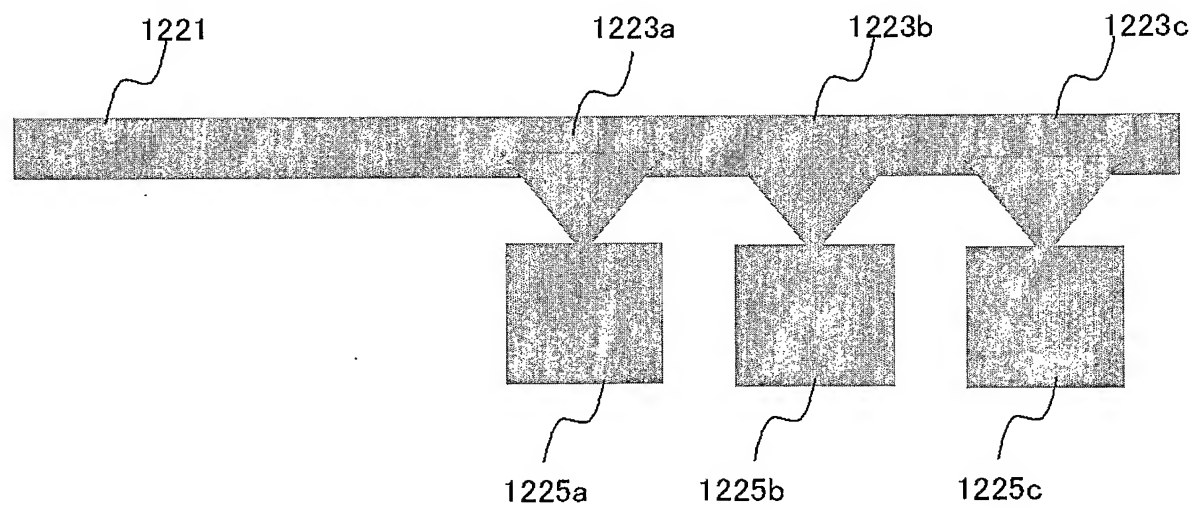
【図 3 1】



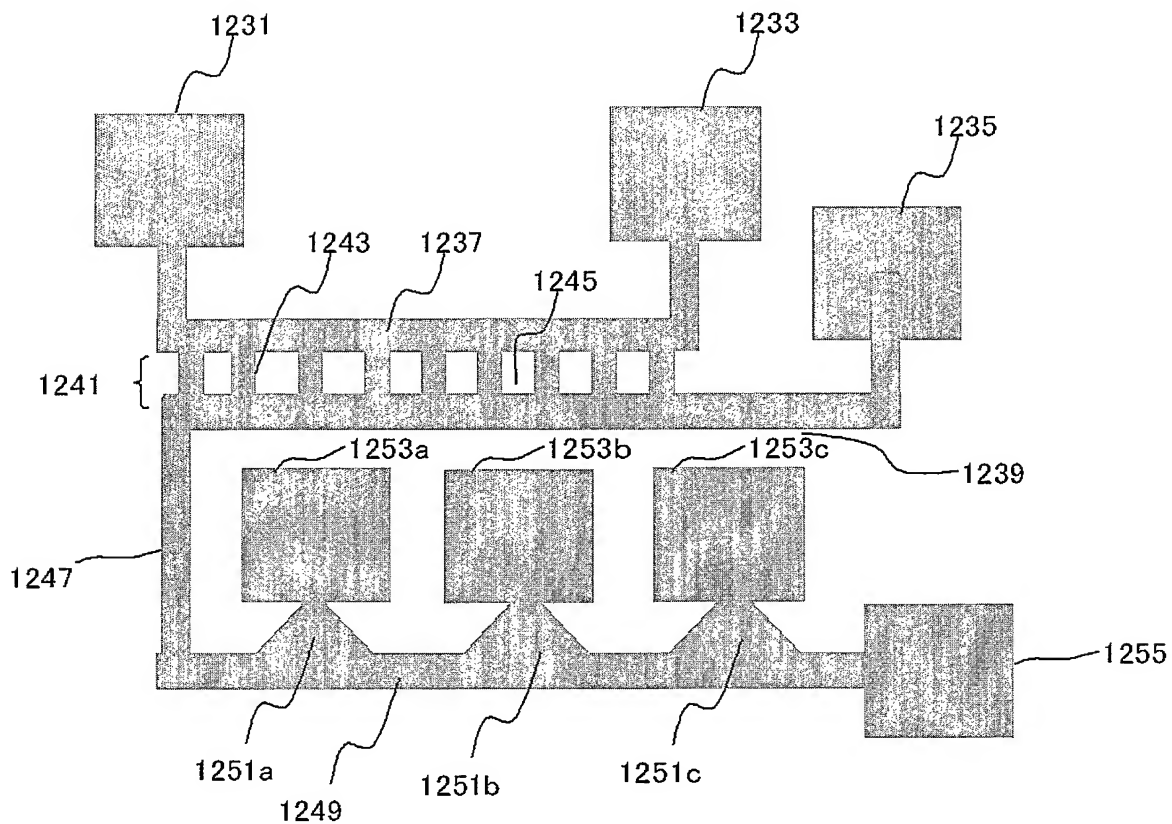
【図 3 2】



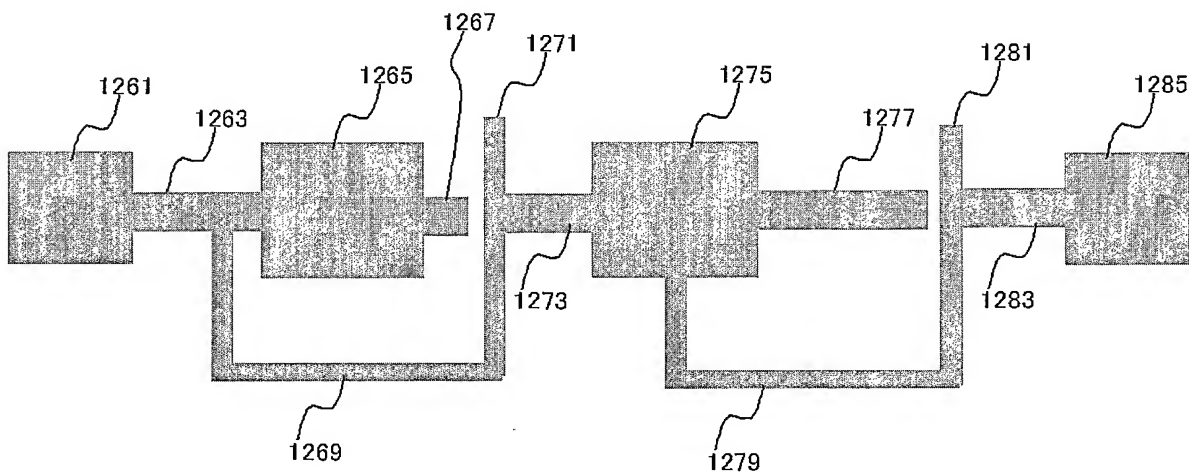
【図 3 3】



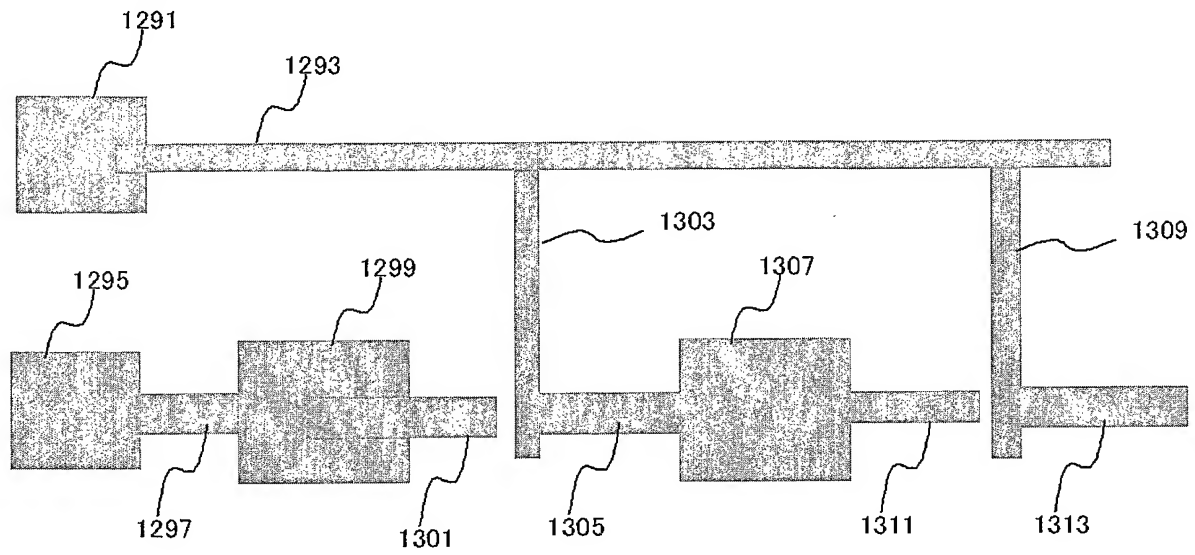
【図 3 4】



【図 3 5】



【図 36】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 微細なスケールで液体の通過を制御する制御構造を実現する技術を提供することを目的とする。または、微細なスケールでグラディエント液を作成するグラディエント形成装置を実現する技術を提供することを目的とする。

【解決手段】 第一の液体の通る第一の流路101と、第一の流路101に連通し、第一の液体を堰き止める堰き止め部104と、第二の液体を堰き止め部104に導く第二の流路102と、を備え、第一の流路101から第二の流路102への第一の液体の通過を制御する制御構造204を提供する。または、第一の組成液が通る順流路405と、順流路405と並行し、第二の組成液が通る逆流路404と、順流路405と逆流路404とを隔て、第一の組成液または第二の組成液の少なくとも特定成分が通過可能な隔壁406と、を備えるグラディエント形成装置を提供する。

【選択図】 図15

特願 2 0 0 4 - 0 3 1 4 3 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 2 3 7]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名

日本電気株式会社